

อภินันพนาการ

สัญญาเลขที่ R2559C054



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกโพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาใหม่

Phase Evolution and Electrical Properties of a New System of (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ Piezoelectric Ceramics Synthesized by the Combustion Technique



อ.คุกรพรรณ ชูถิน
ผศ.ดร.ธีระชัย บงกชารณ์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันลงทะเบียน... 1 ส.ค. 2562.....
เลขทะเบียน... 1020417.....
เลขเรียกหนังสือ... ๙ ๖๖ • ๓๗๘

๑๕
๐๗๑๔๑
๒๕๕๙

สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยและคณบดีขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านซึ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

ขอขอบคุณ Science Lab Center คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย

อ.ศุภพรรณ ชูถิน และคณะ



หัวข้อวิจัย การพัฒนาเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกโพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่
(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาใหม่

นักวิจัย อ.ศุภารบรรณ ชูณิน
ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์

บทคัดย่อ

เซรามิกโพอิโซอิเล็กทริกที่ปราศจากตะกั่ว (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ ที่ปริมาณ $x=0$, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 และ 0.1 ตามลำดับ เตรียมโดยวิธีการเผาใหม่ (combustion) และใช้กลีซินเป็นเชื้อเพลิง ศึกษาผลของปริมาณ x ที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก พบว่าเซรามิกแสดงเฟสเดียวเพอร์อฟสไกท์ที่บริสุทธิ์ในทุกตัวอย่าง โดยที่ $0 \leq x \leq 0.04$ แสดงโครงสร้างเฟสแบบเทหะโนนัล ที่ปริมาณ $x \geq 0.06$ เซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสแบบผสมระหว่างเทหะโนนัลและรอมโบไฮดรัล และที่ปริมาณ $x > 0.06$ พบว่าเซรามิกมีโครงสร้างเฟสเข้าสู่รอมโบไฮดรัลมากขึ้น โครงสร้างจุลภาคของเซรามิก (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ แสดงลักษณะของเกรนเซรามิกที่ค่อนข้างเป็นเหลี่ยมและขนาดเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส (T_d) และ อุณหภูมิคูรี (T_m) มีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น ค่า γ ของเซรามิกมีค่าอยู่ระหว่าง 1.03 - 1.06 ซึ่งแสดงสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกแบบปกติในทุกตัวอย่าง บริเวณรอยต่อเฟส (MPB) เกิดขึ้นที่ปริมาณ $x = 0.06$ เนื่องจากเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]- 0.06 BCTZ แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด ($\varepsilon_m \sim 2971$) สมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกที่ดี ($P_r \sim 20.83 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ และ $E_c \sim 13.74 \text{kV}/\text{cm}$) และค่าคงที่โพอิโซอิเล็กทริกสูงสุด ($d_{33} \sim 237 \text{ pC/N}$)

Research Topic: Phase Evolution and Electrical Properties of a New System of
(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ Piezoelectric Ceramics Synthesized
by the Combustion Technique

Researcher: Miss. Suphornphun Chootin
Assist. Prof. Dr.Theerachai Bongkarn

ABSTRACT

Lead free piezoelectric (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ ceramics with x content from 0 to 0.1 step 0.02 were prepared via the solid state combustion technique and glycine was used as a fuel. The effect of x concentration on the phase evolution, microstructure and electrical properties were methodically investigated. The XRD result of $0 \leq x \leq 0.04$ showed a tetragonal phase. The co-existence phase between the rhombohedral and the tetragonal structure was observed at $x \geq 0.06$. The phase structure at a composition between 0.08 and 0.1 was dominated by a higher rhombohedral phase. The ceramics gain exhibited a cubic shape and the average gain size decreased from 1.15 to 0.83 μm with an increase in x content from 0 to 0.1. The depolarization temperature (T_d) and maximum dielectric temperature (T_m) of the ceramics tended to decrease with increasing x concentration. The diffuseness constant (γ) in this system were about 1.03 and 1.06 which indicated a normal ferroelectric in all samples. The MPB composition was suggested at x around 0.06 where this ceramic exhibited its highest dielectric constant ($\epsilon_m=2971$), good ferroelectric properties ($P_r \sim 20.83 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ and $E_c \sim 13.74 \text{ kV}/\text{cm}$) and excellence piezoelectric constant ($d_{33}=237 \text{ pC}/\text{N}$).

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

บิสมัทโซเดียมไททาเนต (Bismuth Sodium Titanate; BNT) เป็นเซรามิกโพอิโซอิเล็กทริกที่ปราศจากสารตะกั่ว ถูกค้นพบโดย Smolenskii ในปี ค.ศ.1960 BNT เป็นเซรามิกที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเซรามิก BNT แสดงอุณหภูมิคริวที่สูง ($T_c \approx 320^\circ\text{C}$) และค่าสภาพขั้วคงค้างสูง ($P_r \approx 38 \mu\text{C/cm}^2$) [1-3] แต่อย่างไรก็ตามเซรามิก BNT แสดงค่าสนามไฟฟ้าลับล้างที่สูง ($E_c \approx 73 \text{ kV/cm}$) ค่าสัมประสิทธิ์โพอิโซอิเล็กทริกที่ต่ำ ($d_{33} \approx 90 \text{ pC/N}$) และยังใช้สนามไฟฟ้าที่สูงในการทำขั้วไฟฟ้า ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีนักวิจัยจำนวนมากสนใจที่จะศึกษาและปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNT โดยการเพิ่มองค์ประกอบของการเตรียมเซรามิกในหัวภาคและไตรภาค เช่น (0.8)BNT-(0.2)BKT [4], (1-x)BNT-xBT [5], (1-x)BNT-xBCTZ [6], (1-x)BNT-xKNN [7], (1-x-y)BNT-xBT-yBKT [8] และ (1-x-y)BNT-xBKT-yKNN [9] เป็นต้น

เมื่อไม่นานมานี้ R. SUMANG และคณะ [10] ได้ทำการศึกษาการเตรียมเซรามิกโพอิโซอิเล็กทริกที่ปราศจากตะกั่วแบบไตรภาค ของ $(0.81)\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3 - (0.18)\text{Bi}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{TiO}_3 - (0.01)\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{NbO}_3$; (BNT-BKT-KNN) โดยวิธีการเผาใหม่ พบว่าเซรามิกนี้แสดงสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีโดยเซรามิกดังกล่าวแสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกประมาณ 5200 มีค่าสภาพขั้วคงค้าง $P_r = 22 \mu\text{C/cm}^2$ มีค่าสนามไฟฟ้าลับล้าง $E_c = 14.3 \text{ kV/cm}$ อุณหภูมิคริวที่สูง $T_c = 270^\circ\text{C}$ และค่าสัมประสิทธิ์โพอิโซอิเล็กทริกที่สูง ($d_{33} = 168 \text{ pC/N}$) แต่อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์โพอิโซอิเล็กทริกยังถือว่าเป็นค่าที่ต่ำหากจะนำไปประยุกต์ใช้แทนเซรามิกโพอิโซอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ

เซรามิก $(\text{Ba}_{0.90}\text{Ca}_{0.10})(\text{Ti}_{0.85}\text{Zr}_{0.15})\text{O}_3$; (BCTZ) เป็นเซรามิกโพอิโซอิเล็กทริกปราศจากตะกั่วชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากแสดงโครงสร้างพ่อไก๊ต (perovskite, ABO_3) แบบออร์โตรอมบิกที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ยังมีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี เช่น ค่าสัมประสิทธิ์โพอิโซอิเล็กทริก (d_{33}) สูง (600 pC/N) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง (10000) และมีค่าสนามไฟฟ้าลับล้างต่ำ ($E_c = 14 \text{ kV/cm}$) แต่อย่างไรก็ตามเซรามิก BCTZ มีอุณหภูมิคริวที่ต่ำมาก ($T_c \sim 80^\circ\text{C}$) [12,13] ทั้งนี้คาดว่าการเติม BCTZ เข้าไปในระบบ BNT-BKT-KNN จะสามารถปรับปรุงค่า d_{33} และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

เรื่องนี้การเตรียมเซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริกโดยวิธีการเผาใหม่ (combustion technique) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวิธีที่ทำให้เซรามิกมีความหนาแน่นสูง สมบัติไดอิเล็กทริก

สมบัติไฟอิโซอิเล็กทริกและสมบัติเฟรโรอิเล็กที่ดี [14-20] การเตรียมเซรามิกโดยวิธีการเผาใหม่เป็นวิธีที่ได้รับการพัฒนาจากวิธีปฏิกริยาสถานะของแข็ง ซึ่งการเตรียมเซรามิกด้วยวิธีการเผาใหม่นี้ทำให้ได้ผลลัพท์ที่มีความบริสุทธิ์ และมีความเป็นเนื้อเดียวกันสูง ขนาดอนุภาคเล็กและใช้อุณหภูมิในการเผาต่ำ เนื่องจากวิธีการเผาใหม้อาศัยการปลดปล่อยพลังงานที่ได้จากการจุดระเบิดซึ่งเกิดจากปฏิกริยาเคมีของเชือเพลิง พลังงานที่ได้จากการจุดระเบิดนี้ ช่วยให้อุณหภูมิในการเผาสารลดลงและเกิดปฏิกริยาระหว่างสารตั้งต้นในระดับโน้มเลกูลอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีปฏิกริยาสถานะของแข็ง [16-22] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกเติม BCTZ ในระบบ $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ที่ปริมาณ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08$ และ 0.1 ตามลำดับ ด้วยวิธีการเผาใหม่ แล้วศึกษาผลของปริมาณ x ที่มีต่อโครงสร้างผลลัพท์โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิชินเตอร์ที่เหมาะสมในการเตรียมเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ด้วยวิธีการเผาการเผาใหม่
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมในการเตรียมเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ด้วยวิธีการเผาการเผาใหม่ โดยที่ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08$ และ 0.1 ตามลำดับ
3. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิชินเตอร์และปริมาณ x ที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาค สมบัติไดอิเล็กทริก สมบัติไฟอิโซอิเล็กทริกและสมบัติเฟรโรอิเล็กทริกของเซรามิก $(BNT-BKT-KNN)-BCTZ$

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

1. เตรียมเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ที่ปริมาณ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1$ ด้วยวิธีการเผาใหม่ โดยใช้อุณหภูมิชินเตอร์ระหว่าง $1075-1175^{\circ}\text{C}$
2. นำเซรามิกที่ได้จากข้อ 1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพ โครงสร้างผลลัพท์ ความหนาแน่น โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องรากัด สมบัติไดอิเล็กทริกด้วยเครื่อง LCR สมบัติไฟอิโซอิเล็กทริกด้วยเครื่อง computer controller modified Sawyer-Tower circuit และสมบัติเฟรโรอิเล็กทริกด้วยเครื่อง quasi-static d_{33} testing meter

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสืออ้างอิง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล
2. เตรียมผงผลึก BNT-BKT-KNN ด้วยวิธีการเผาไหม้ โดยแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 750°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
3. เตรียมผงผลึก BCTZ ด้วยวิธีการเผาไหม้ โดยแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 1050°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
4. เตรียมเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-x\text{BCTZ}$ ที่ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1$ โดยใช้อุณหภูมิชินเตอร์ $1075-1175^{\circ}\text{C}$ แล้วศึกษาโครงสร้างจุลภาค หากค่าความหนาแน่น ร้อยละการหดตัว ขนาดเกรนเฉลี่ยจากเซรามิก วัดสมบัติไดอิเล็กทริก สมบัติไฟฟ้าอิเล็กทริกและสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก
5. สรุปผลการทำโครงการ จัดทำรูปเล่ม และเตรียมการนำเสนอ

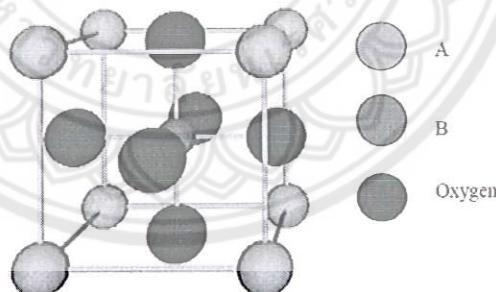


บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ (perovskite structure)

โครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์ เป็นชื่อที่เรียกกันตามชื่อของแร่แคลเซียมไททาเนต (CaTiO_3) มี สูตรโครงสร้างทั่วไปเป็น ABO_3 เมื่อ A และ B เป็นไอโอนบวก ซึ่งมีขนาดใหญ่อนใหญ่และเล็ก ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 1 โครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์นี้มีพื้นฐานมาจากหน่วยเซลล์แบบ Face-center cubic closed packing (FCC) โดยไอโอนบวก A และออกซิเจนซึ่งเป็นไอโอนลบ จะจัดเรียง โครงสร้างแบบ FCC ไอโอนบวก A จะอยู่ที่มุมของหน่วยเซลล์ ออกซิเจนจะอยู่ที่หน้าของหน่วยเซลล์ และไอโอนบวก B จะแทรกอยู่ในช่องว่างกลางทรงแปดเหลี่ยม (octahedral side) สารประกอบที่มี โครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์จะรวมไปถึงพักราประกอบในกลุ่มไททาเนต (titanates) หลาย ๆ ชนิดที่นิยมนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เชิงมิคрогานาเดอร์ อย่างเช่น BaTiO_3 SrTiO_3 และ PbTiO_3 สารประกอบในกลุ่มเซอร์โคเนต (zirconates) อย่างเช่น PbZrO_3 และ BaZrO_3 และ สารประกอบในกลุ่มอื่น ๆ เช่น LaGaO_3 LaAlO_3 และ KNbO_3 เป็นต้น นอกจากนี้โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ยังจัดเป็นส่วนประกอบอย่างหน่วย โครงสร้างที่อยู่ภายใต้โครงสร้างที่มีความ слับซับซ้อนมาก ๆ บางประเภท อย่างเช่นสารตัวนำயวดยิ่ง (superconductors) อีกด้วย

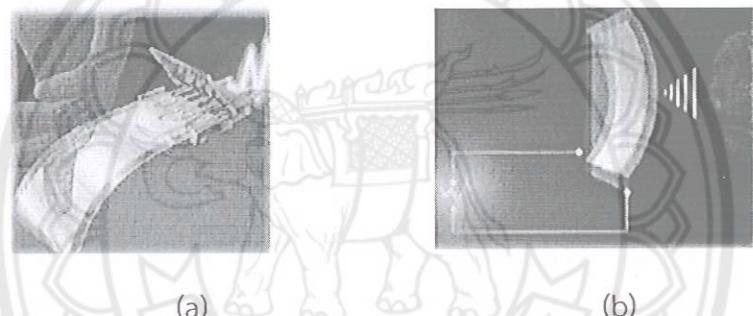


รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์ (ABO_3)

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า หากสารเฟริโอเล็กทริกได้รับอุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิครูร์ของสารนั้น แล้ว สารดังกล่าวจะกลายสภาพเป็นพาราอิเล็กทริก โดยผลก็มีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของ หน่วยเซลล์ ผลที่ตามมาคือ สารจะไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตนเองได้ และเมื่อลดอุณหภูมิ ดังกล่าวลงให้ต่ำกว่าอุณหภูมิครูร์ สารดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนสภาพจากพาราอิเล็กทริกไปเป็นเฟริโอ เล็กทริกเช่นเดิม ทำให้ที่ตำแหน่งศูนย์กลางมีการเปลี่ยนตำแหน่ง และโครงสร้างผลึกแบบคิวบิกจะ เปลี่ยนเป็นโครงสร้างผลึกที่ไม่มีความสมมาตรกับศูนย์กลาง ตัวอย่างโครงสร้างดังกล่าว เช่น เทหะ โภนัล (Tetragonal) รอมโบไฮดราล (rhombohedral) หรือโมโนคลินิก (monoclinic)

2.2 สมบัติไฟอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric property)

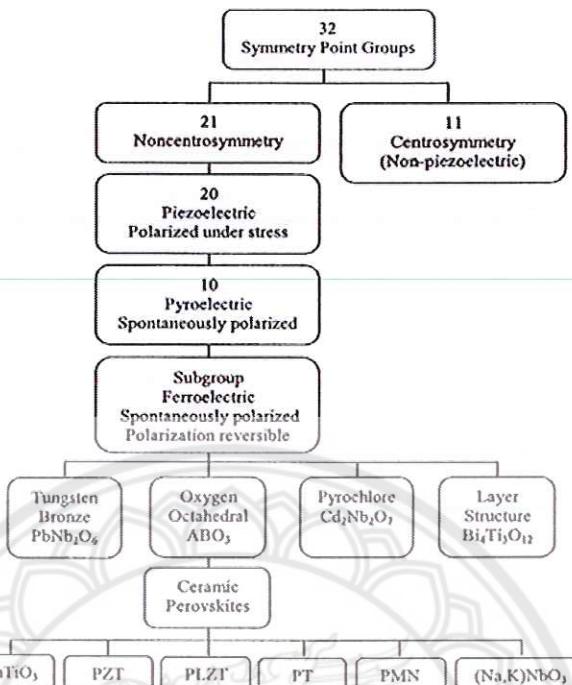
ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกของวัสดุถูกค้นพบในปี 1880 โดย Jacques และ Pierre Curie โดยการศึกษาอิทธิพลของแรงกดต่อประจุไฟฟ้าของผลึก เช่น ควอทซ์ (Quartz) ชิงค์เบลนด์ (Zinc blende) และ หัวร์มาไลน์ (Tourmaline) เป็นต้น โดยชื่อ “piezo” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก หมายถึง “การกด” ซึ่งปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกคือ ปรากฏการณ์ที่วัสดุสามารถเกิดขึ้นไฟฟ้า (Electrical polarization) ขึ้นเนื่องจากความเครียด (Strain) ในวัสดุ เมื่อได้รับความเค็น (Stress) เข้าไป โดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกโดยตรง (Direct piezoelectric effect)” ดังแสดงในรูปที่ 2(a) และในทางกลับกันเมื่อมีการให้สนามไฟฟ้าแก่วัสดุไฟอิโซอิเล็กทริกแล้ว สามารถเกิดความเครียดซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไปได้นั้น จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกโดยอ้อม (Converse piezoelectric effect)” ดังแสดงในรูปที่ 2(b)



รูปที่ 2 (a) ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกโดยตรง และ (b) ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกโดยอ้อม

สำหรับวัสดุไฟอิโซอิเล็กทริกนั้นต้องการสัมประสิทธิ์ไฟอิโซอิเล็กทริกและค่าสภาพยอมสัมประสิทธิ์ที่มีค่าสูง เพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์ที่มีการสั่นและการเคลื่อนไหว เช่น เครื่องสัญญาณสะท้อน (sonar) และเครื่องสำหรับรับฟัง (sounder)

โดยทั่วไปผลึกนั้นสามารถแบ่งกลุ่มตามสมมาตรได้ 32 กลุ่ม โดย 11 กลุ่มนั้นมีลักษณะสมมาตรผ่านจุดศูนย์กลาง (Centro symmetry) ส่วนที่เหลืออีก 21 กลุ่มนั้นมีลักษณะสมมาตรไม่ผ่านจุดศูนย์กลาง (Non-Centro symmetry) ซึ่งผลึกในกลุ่มนี้จะแสดงสมบัติทางไฟอิโซอิเล็กทริก 20 กลุ่ม ส่วนอีก 1 กลุ่มไม่แสดงสมบัติทางไฟอิโซอิเล็กทริก เนื่องจากผลึกจะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างที่มีสมมาตรผ่านจุดศูนย์กลางเมื่อได้รับแรงกระทำโดยผลึกไฟอิโซอิเล็กทริกทั้ง 20 กลุ่มนี้ มีเพียง 10 กลุ่มที่สามารถเกิดโพลาไรซ์ได้เอง (Spontaneous polarization)



รูปที่ 3 แผนภาพแสดงการแบ่งกลุ่มไฟอิโซเล็กทริกและกลุ่มย่อย [11]

2.3 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริก

ปรากฏการณ์เฟรโรอิเล็กทริกถูกค้นพบครั้งแรกโดย J. Valasek ในปี ค.ศ. 1921 ในผลึกเชิงเดี่ยว (Single crystal) ของเกลือโรเชลล์ (Rochelle salt) ซึ่งปรากฏการณ์เฟรโรอิเล็กทริก คือ ปรากฏการณ์ของผลึกที่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้เอง แม้ว่าไม่ได้ถูกเหนี่ยวนำโดยสนามไฟฟ้าภายนอก และโพลาไรเซชันนี้สามารถสลับข้าม (switching) ได้ โดยการให้สนามไฟฟ้าภายนอกที่เหมาะสม

2.3.1 เฟรโรอิเล็กทริกแบบปกติ

สารเฟรโรอิเล็กทริกเป็นสารที่ไม่มีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ จึงทำให้สามารถสร้างได้โพลีชีนมาได้โดยไม่ต้องได้รับแรงกล ซึ่งสามารถแยกสารเฟรโรอิเล็กทริกออกจากวัสดุได้อิเล็กทริก ด้วยการตกค้างหรือรีเมานท์ โพลาไรเซชัน (remanent polarization: P_r) เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเป็นศูนย์ [24] โดยปกตินั้นโพลาไรเซชัน (P) เป็นผลมาจากการให้สนามไฟฟ้าซึ่งจัดเรียงข้ามคู่อิเล็กตรอน (atomic dipole) หรือขั้วโมเลกุล (molecular dipole) อย่างเป็นระเบียบ ในสารหลายชนิดโพลาไรเซชันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้า \vec{E} มีความเข้มน้อย

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad (1)$$

เมื่อ χ_e เป็นค่าคงที่เรียกว่าสภาพรับได้ทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของตัวกลาง ค่าของ χ_e ขึ้นกับโครงสร้างทางจุลภาค (microscopic structure) ของสารที่พิจารณาและ ϵ_0 เป็น

สภาพ ยอมของสูญญากาศ (permittivity of a vacuum) มีค่าคงที่ประมาณ $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ โปรดสังเกตว่าสนามไฟฟ้า E ในสมการ (1) นี้เป็นสนามไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากส่วนของประจุอิสระและส่วนของโพลาไรเซชันที่สนาม \bar{E} ผลิตขึ้นเอง

χ_e ไม่มีทิศทาง และการจัดไฟฟ้า (electric displacement: D) จากการกระจายประจุอิสระเท่านั้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามสมการ (2)

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + P \quad (2)$$

จากสมการ (1) และ (2) จะได้ความสัมพันธ์เป็น

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \epsilon_0 \chi_e \bar{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \bar{E} \quad (3)$$

ดังนั้นไม่เพียงแต่ P เท่านั้นที่ขึ้นกับ \bar{E} แต่ \bar{D} ก็ขึ้นกับ \bar{E} ด้วยเช่นกัน

$$\bar{D} = \epsilon \bar{E} \quad (4)$$

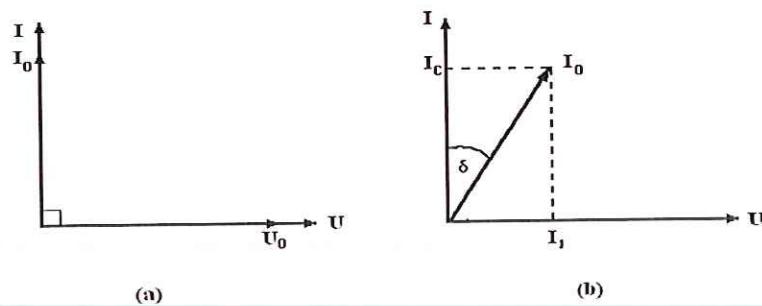
$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \quad (5)$$

เรียก ϵ ว่าสภาพยอม (Permittivity) ของวัสดุในสูญญากาศ ไม่มีสารใดก่อให้เกิดโพลาไรซ์ ดังนั้นสภาพรับไว้ได้ทางไฟฟ้าจะเป็นศูนย์และสภาพยอม (ϵ) จะมีค่าเท่ากับ ϵ_0 และจากสมการ (5) จะได้

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (6)$$

เมื่อ ϵ_r คือสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) หรือ ค่าคงที่โดยอิเล็กทริกในวัสดุเฟอร์โร อิเล็กทริก ส่วนใหญ่ค่าคงที่โดยอิเล็กทริก ϵ_r จะมีค่าสูง ดังนั้น $P >> \epsilon_0 \bar{E}$ และ $D \approx P$ เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้กับวัสดุโดยอิเล็กทริก สนามไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเป็นเหตุให้เกิดได้โดยภายในวัสดุโดยอิเล็กทริก ในกรณีอุดมคติ ได้โดยภายในวัสดุโดยอิเล็กทริกสามารถสัมภารณ์กระแสสลับทิศทางได้ตามความถี่ของแหล่งกำเนิด กรณีกระแสสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (V) มีความต่างเฟสกันอยู่ 90 องศา ดังรูปที่ 4(a) ทำให้ผลคูณสเกลาร์ (scalar product) ของ I และ V เท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานของวัสดุโดยอิเล็กทริก (dielectric loss: $\tan \delta$) เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงการสัมภารณ์ของไดโอดจะก่อให้เกิดความต้านทานภายในเนื้อวัสดุเอง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขึ้น ซึ่งกรณีกระแสไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้ามีความต่างเฟสกันน้อยกว่า 90 องศา ดังรูปที่ 4 (b) โดยการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นนั้นสามารถวัดได้จากการทดลองและเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับสภาพยอม

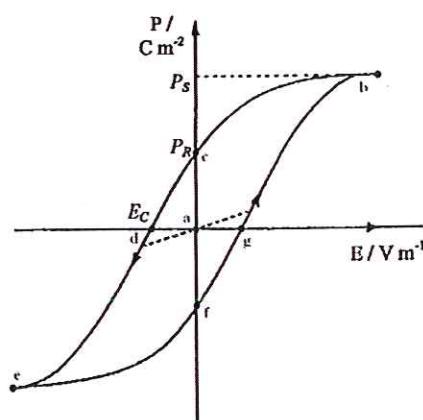
$$\tan \delta = \frac{\epsilon_r''}{\epsilon_r'} \quad (7)$$



รูปที่ 4 ความต่างเฟสระหว่างกระแสสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (V) ของวัสดุโลหะทริก
(a) กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน (b) กรณีมีการสูญเสียพลังงาน

ในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกการสลับทิศทางของไดโอลตามความถี่ของแหล่งกำเนิด ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างการโพลาไรเซชันและสนามไฟฟ้า (Polarization versus field) ซึ่งความสัมพันธ์ จะเป็นรูปของวงรอบไฮสเตอเรซิส (hysteresis loop) ดังรูปที่ 5

เมื่อให้สนามไฟฟ้าเข้าไปครั้งแรกการเกิดโพลาไรเซชันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งถึง จุดอิ่มตัว (saturation polarization) คือจุด b ซึ่งการเกิดโพลาไรเซชันมีค่ามากที่สุด ไดโอลทั้งหมด จะเรียงตัวนานกัน และหากเพิ่มสนามไฟฟ้าไปมากกว่านั้น ก็ไม่มีผลต่อการเกิดโพลาไรเซชัน เมื่อ สนามไฟฟ้ามีค่าลดลงแทนที่การโพลาไรเซชันจะถอยกลับไปตามเส้นทางเดิมเหมือนตอนเริ่มต้น ($P = 0$) แต่กลับไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกัน แม้ว่าไม่มีการให้สนามไฟฟ้า ($E = 0$) แก่วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกก็ ตาม แต่ยังคงมีโพลาไรซ์หลงเหลืออยู่ หรือรีเมานท์ โพลาไรเซชัน (remanent value: P_R) ที่จุด C ถ้าเราต้องการกำจัดโพลาไรเซชันที่ยังหลงเหลืออยู่ เราต้องให้สนามไฟฟ้าย้อนกลับทิศทางเดิม (นั่นคือ $-E$) โพลาไรเซชันจะลดลงสู่ศูนย์ที่จุด d ซึ่งเรียกจุดนี้ว่า สนามโคเօร์ซีฟ (coercive field: E_C) ถ้าเรา พยายามให้สนามไฟฟ้าในทิศทางลบนี้สูงขึ้นอีก ในที่สุดก็จะถึงจุดอิ่มตัว ที่จุด g ข้ามไดโอลทั้งหมดซึ่งเป็น ทางขวา เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ถ้าไม่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก เล้าปล่อยให้วัสดุที่มีโพลา ไรเซชันเพิ่มขึ้นไปทางขวา ยังจุด f เพื่อให้ครบวงจร ต้องป้อนกระแสไฟฟ้าอีกครั้งในทิศทางบวก โพลา ไรเซชันจะกลับสู่ศูนย์ที่จุด g และในที่สุดก็จะมุ่งไปสู่จุดอิ่มตัวที่จุด b [23,24]

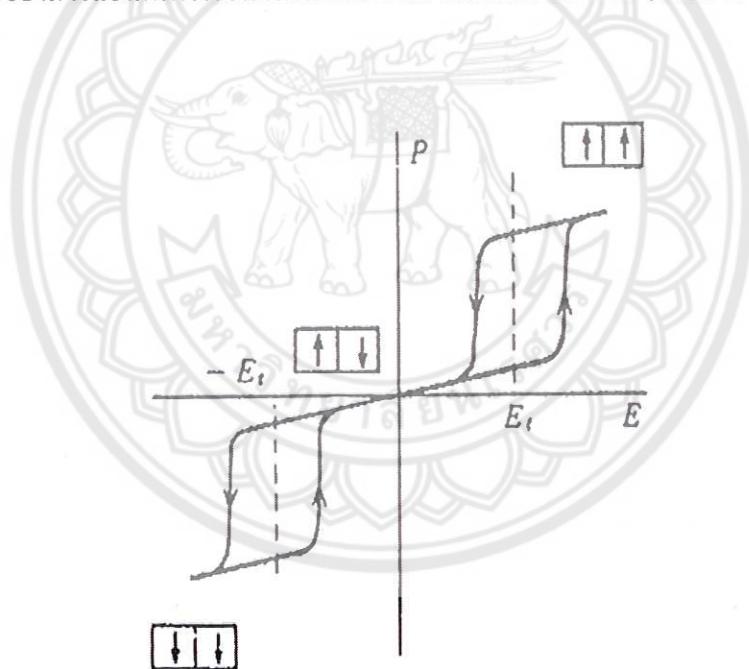


รูปที่ 5 วงรอบไฮสเตอเรซิสระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารเฟอร์โรอิเล็กทริก [24]

2.3.2 แอนติเฟร์โรอิเล็กทริก (Anti ferroelectric)

สารแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกเป็นสารที่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับแรงกล เข่นเดียวกับสารเฟร์โรอิเล็กทริก แต่ทิศทางของโพลาไรเซชันในแต่ละโดเมน (โดเมน คือ บริเวณที่หน่วยเซลล์มีสภาพขั้วเหมือนกัน) จะมีทิศทางตรงกันข้ามกันกับการหักล้างกัน ทำให้ค่าโพลาไรเซชันสุทธิ (net polarizations) มีค่าเป็นศูนย์ สารแอนติเฟร์โรบางชนิดเมื่อถูกเหนี่ยวนำโดยสนามไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นสารเฟร์โรอิเล็กทริกได้ [25]

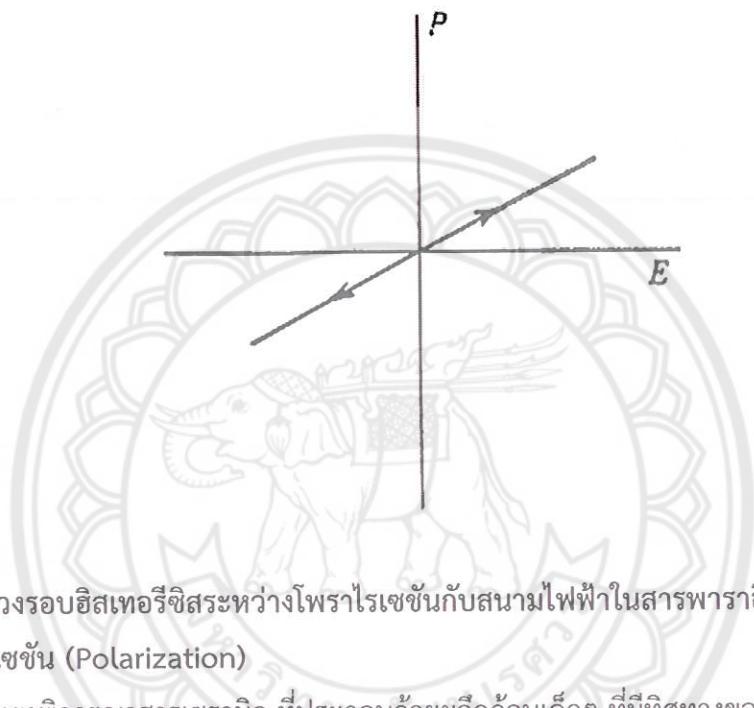
ในสนามไฟฟ้าต่ำ สารแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกจะมีค่าโพลาไรเซชันที่ถูกเหนี่ยวนำ (induced polarizations) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเกินกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤต (critical field, E_{crit}) ทำให้ผลึกภายในเป็นเฟร์โรอิเล็กทริกและโพลาไรเซชันจะแสดงอิสเทอเรชันที่มีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้า หากหยุดป้อนสนามไฟฟ้าดังกล่าวผลึกจะกลับเป็นสถานะแอนติโพลาร์ (anti polar state) และโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะนั้น โดยรูមชาติของสารแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกจะมีวงรอบอิสเทอเรชัน 2 วง (double hysteresis curve) ดังรูปที่ 6



รูปที่ 6 วงรอบอิสเทอเรชันระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าของสารแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก [25]

2.4 พาราอิเล็กทริก (Paraelectric)

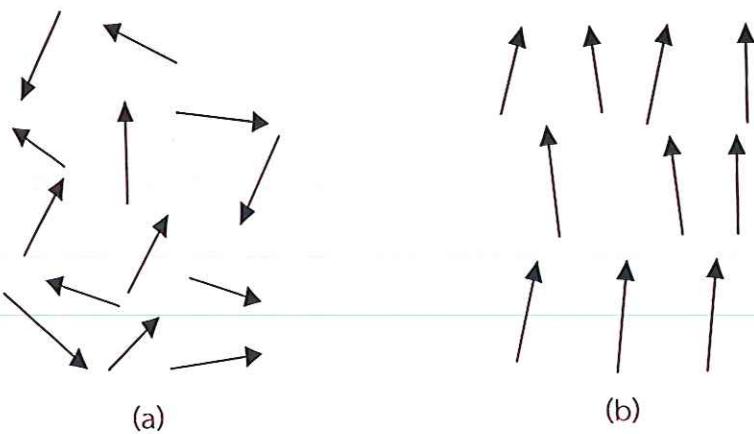
เฟสพาราอิเล็กทริกเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเฟสเฟร์โรอิเล็กทริกและเฟสแอนดิเฟร์โรอิเล็กทริก [25] ซึ่งสารพาราอิเล็กทริกจะประพฤติตัวเป็นวนวนตามปกติ มีโครงสร้างที่สมมาตร จึงไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตนเอง เมื่อมีการป้อนสนามไฟฟ้าให้กับสารพาราอิเล็กทริก ทำให้เกิดโพลาไรเซชันขึ้น แต่เมื่อยุดป้อนสนามไฟฟ้าเข้าไป ผลก็คือไม่มีการเกิดโพลาไรเซชันขึ้นอีก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 7



รูปที่ 7 วงรอบยิสเทอเริชีสระบุว่าโพราไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารพาราอิเล็กทริก [25]

2.5 โพราไรเซชัน (Polarization)

เมื่อเราพิจารณาสารเซรามิก ที่ประกอบด้วยผลึกก้อนเล็กๆ ที่มีทิศทางของไดโอลต่างกัน การที่ไดโอลไม่เรียงตัวเป็นระเบียบนี้ ทำให้เซรามิกไม่สามารถวัดค่าไฟอิโซอิเล็กทริกได้แต่เมื่อมีการให้สนามไฟฟ้าเข้าไปในสารตัวอย่าง หรือการสร้างขึ้นให้แก่สาร (poling) นี้จะทำให้เกิดโพลาไรเซชัน หรือไดโอลภายใต้การอยู่ในทิศทางใกล้เคียงกัน หรือทิศทางเดียวกันกับทิศทางของสนามไฟฟ้าที่เข้าไป ดังรูปที่ 8 เพื่อเพิ่มสมบัติการเป็นไฟอิโซอิเล็กทริก และสมบัติทางไฟฟ้าด้วย [23]



รูปที่ 8 ไดโพลภายในเนื้อสาร (a) ก่อนทำการ poling และ (b) หลังทำการ poling [23]

2.6 สมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric property)

วัสดุไดอิเล็กทริก เป็นชนิดหนึ่งของอนุวนชีงไม่น้ำไฟฟ้า และยังสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้อีกด้วย [26] ซึ่งค่าความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าของสารไดอิเล็กทริก เรียกว่า ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance) เมื่อใส่สนามไฟฟ้าแก่สารไดอิเล็กทริก สารไดอิเล็กทริกจะเกิด polarization ขึ้นซึ่งเท่ากับ ค่าผลรวมของโพลาไรเซชันต่อหน่วยปริมาตร (net polarization/unit volume) ซึ่งหากค่า polarization สูงก็จะส่งผลให้สารไดอิเล็กทริกมีค่า capacitance สูงตามไปด้วย โดยสมบัติทางไดอิเล็กทริกมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ตัว คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity: ϵ_r) ความคงทนไดอิเล็กทริก (dielectric strength) และค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss)

2.7 ผลของโครงสร้างจุลภาคที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กทริก

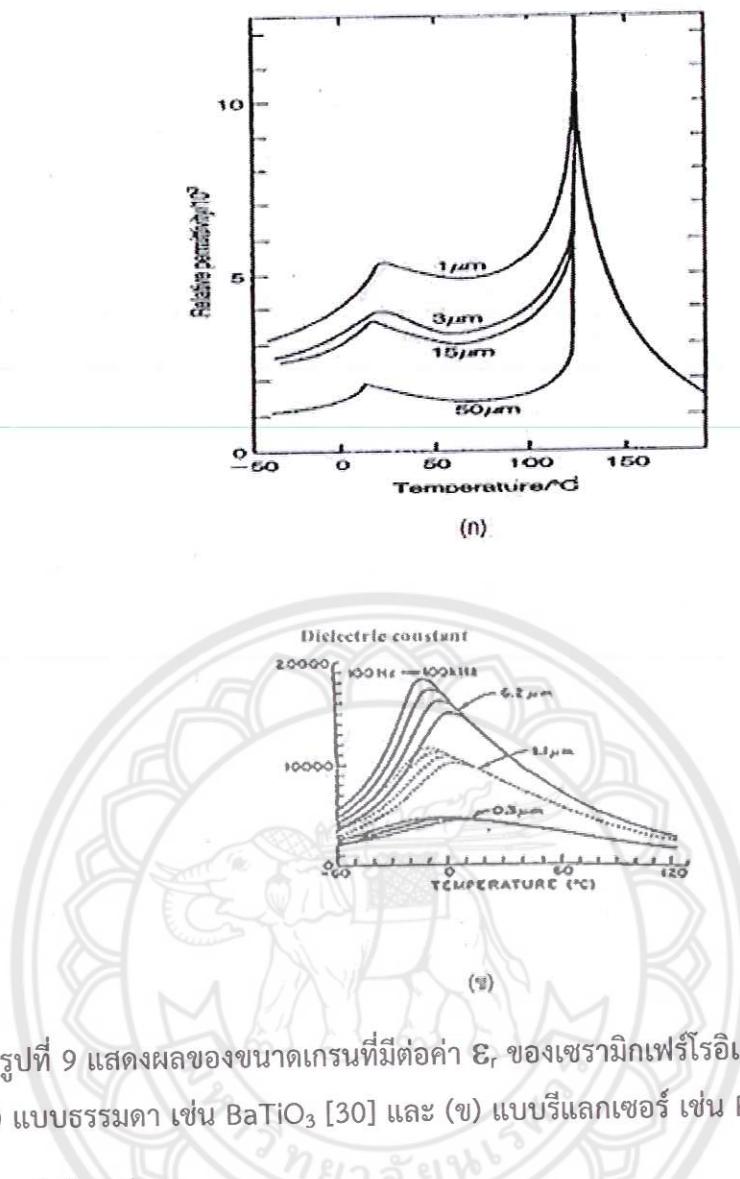
ภายในเนื้อของวัสดุพวกรเซรามิกออกใช้ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ผลึกที่มีโครงสร้างที่แน่นอนโดยมีอัตราการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบตลอดทั่วทั้งเนื้อของวัสดุ ซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังจากที่ได้มีการให้ความร้อนที่เหมาะสมแก่วัสดุแล้วปล่อยให้เย็นตัวลง โดยที่ผลึกที่อยู่ภายในเนื้อสารได้รับความร้อนก็จะเกิดการเติบโต ทำให้มีรูปทรงเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเกิดการเคลื่อนที่ขันกันของขอบผลึกอื่นๆ จนเกิดเป็นโครงสร้างทางจุลภาคที่มีลักษณะเฉพาะและประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่าเกรน (grain) เรียงตัวเกาะติดกันตลอดทั่วทั้งวัสดุ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์เข้ามาช่วย และเรียกบริเวณขอบหรือรอบต่อที่เกิดจากการเคลื่อนที่เข้ามาชนนี้ว่าขอบเกรน (grain boundaries) ซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีการจัดเรียงอะตอมอย่างไม่เป็นระเบียบสูง เมื่อเทียบกับการจัดเรียงอะตอมภายในเกรน ทำให้อะตอมที่อยู่บริเวณขอบเกรนมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาสูงกว่าและเนื่องจากอะตอมบริเวณนี้จะอยู่แบบค่อนข้างเป็นอิสระจึงทำให้บริเวณนี้มักมีสีงันเป็นสองสี

ขนาดเกรนของเซรามิกเฟริโรอิเล็กทริก จะมีผลอย่างมากกับค่า E, ของเซรามิกจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าค่า E, สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของเกรนและอุณหภูมิซึ่งเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเซรามิกเฟริโรอิเล็กทริกแบบธรรมด้า เช่น แบบเรียมไททาเนต ซึ่งมีขนาดเกรนประมาณ 1-50 μm มีรายงานผลการวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าเซรามิกที่ประกอบด้วยเกรนที่มีขนาดเล็กจะมีค่า E, สูงมากกว่าเซรามิกที่ประกอบด้วยเกรนที่มีขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามถ้าขนาดของเกรนมีค่าต่ำกว่า 1 μm ไม่رونแล้วค่า E, ของเซรามิกเหล่านี้กับมีแนวโน้มที่ลดลงจากรูปที่ 2.9(g) จะเห็นได้ว่าที่สภาวะพาราอิเล็กทริกนั้นค่า E, จะเป็นไปตามกฎของ Curie – Weiss จากที่ได้กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าขนาดพาราอิเล็กทริกนั้นค่า E, ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการนำเซรามิกไปใช้งาน ดังนั้นจึงได้มีความพยายามที่จะควบคุมขนาดของเกรน เพื่อกำหนดลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกให้มีความเหมาะสมต่อการแสดงสมบัติทางไดอิเล็กทริกตามที่ต้องการเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการที่นิยมใช้กันอยู่ 2 วิธีหลักคือ

- ของสารให้เหมาะสม

 1. การควบคุมขนาดของเกรนด้วยการเลือกใช้เรื่องไข่ในการเตรียมที่เหมาะสม
 2. การเจือสารอื่นเข้าไปในสารหลักเพื่อรับประสมบัติทางไฟฟ้าและโครงสร้างทางจุลภาค

ส่วนกรณีของสารเฟริโรอิเล็กทริกแบบบีแลกเซอร์ เช่น PMN นั้น พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกรานทับค่า E, จะตรงกันข้ามกับกรณีของแนวเรี่ยมไฟฟ้าเนต นั่นคือ เมื่อเกรนของเซรามิกมีขนาดเพิ่มขึ้น ค่า E, จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย [27-29] ดังแสดงในรูปที่ 8(ข) นอกจากนี้ยังพบว่าค่า E, ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีก เช่น ปริมาณเฟสไฟโรคลอร์ (pyrochlore) ที่มักเกิดขึ้นปะปนกับเฟสของ PMN ซึ่งเฟสชนิดเดียวกันนี้จะมีค่า E, ต่ำมาก เนื่องจากไม่ได้เป็นสารพากเฟริโรอิเล็กทริก ทำให้เซรามิกมีค่า E, ลัพธ์ (สุทธิ) ลดลงจากที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ค่าความหนาแน่น (density) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อค่า E, เป็นอย่างมาก เนื่องจากเซรามิกที่มีค่าความหนาแน่นต่ำจะมีช่องว่างหรือรูพรุนอยู่มาก จึงมีค่า E, ของอากาศหรือรูพรุนภายในเซรามิกที่ส่งผลกระทบต่อค่า E, ของเซรามิกดังกล่าวทำให้ค่า E, สุทธิของเซรามิกที่มีความหนาแน่นต่ำมีค่าลดลง ดังนั้นการเตรียมเซรามิกเพื่อให้ได้สมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานตามที่ต้องการ จึงต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ด้วย



รูปที่ 9 แสดงผลของขนาดเกรนที่มีต่อค่า ϵ_r ของเซรามิกเฟริโอเล็กทริก (ก) แบบธรรมด้า เช่น BaTiO_3 [30] และ (ข) แบบบีแลกเซอร์ เช่น PMN [29]

2.8 ค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริก

ในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับกับสารไดอิเล็กทริกนั้น ข้อคู่ทางไฟฟ้าหรือడิโอลินเนื้อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปมา ซึ่งการที่จะเปลี่ยนได้ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ของสนามไฟฟ้าที่ให้ โดยถ้าความถี่สูงเกินไปจะทำให้ไดโอลไม่สามารถปรับตัวให้ทันตามความถี่ทำให้เกิดการหยุดนิ่งของไดโอลเนื่องจากความเสื่อย เมื่อยุดนิ่งนานๆ จะทำให้เกิดความร้อนขึ้น (Loss) ซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่มาของค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริก (Dielectric loss; $\tan\delta$) การใช้งานของวัสดุเฟริโอเล็กทริกแบบจะทุกชนิดมีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าดังนั้น การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุจึงมีความจำเป็นอย่างมากซึ่งค่าสภาพยอมสัมพัทธ์เป็นสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของวัสดุเพียงโดยอิเล็กทริกซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง (High dielectric constant) อยู่ในช่วง 200-10000 เทียบกับวัสดุที่เป็นอนามัยมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง 5-100 เท่ากับการประยุกต์ใช้งานทางด้านตัวเก็บประจุ
- มีค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริกต่ำ (Low dielectric constant) อยู่ในช่วง 0.1% - 7%

3. มีสภาพความต้านทานทางไฟฟ้าสูง (High specific electric resistivity) $> 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$
4. สามารถการเบรกดาวน์ได้พอสมควร (Moderate dielectric breakdown) ประมาณ 100- 120 kV/cm สำหรับเม็ดเซรามิกและประมาณ 500 – 800 kV/cm สำหรับแผ่นเซรามิกบางๆ

2.9 ค่าสภาพย้อมสัมพัทธ์ (Relative permittivity: ϵ_r)

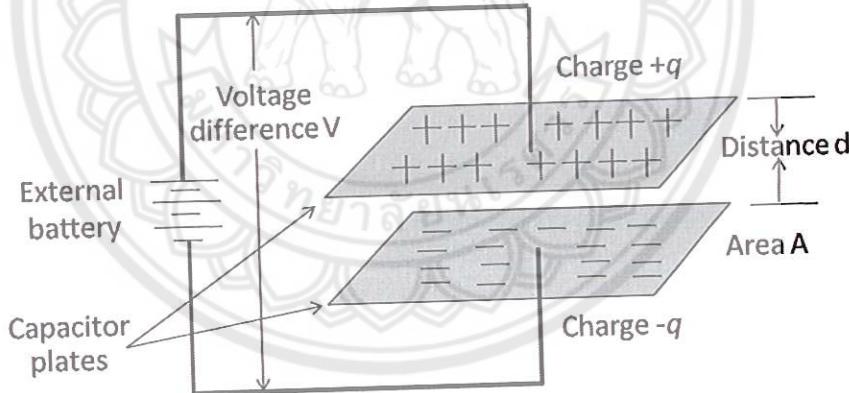
พิจารณาตัวเก็บประจุอย่างง่ายคือ แผ่นขนาดที่ทำด้วยโลหะโดยวางห่างกันด้วยระยะ d พื้นที่ของแผ่นเท่ากับ A ดังแสดงในภาพ 9 ระหว่างแผ่น ขนาดเป็นสูญญากาศ เมื่อมีศักย์ไฟฟ้า V คร่อมแผ่น ขนาดโดยที่แผ่นโลหะแผ่นประจุ $+Q$ และอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นประจุ $-Q$ ค่าประจุนี้จะเป็นสัดส่วนกับ V ดังสมการ 8 [26]

$$Q = CV \quad (8)$$

หรือ

$$C = \frac{Q}{V} \quad (9)$$

เมื่อ C คือ (capacitance) มีหน่วยเป็น คูลومบ์ต่อโวลต์ (C/V) หรือ ฟาร์ด (F)



รูปที่ 10 ตัวเก็บประจุแผ่นขนาด [26]

ความจุไฟฟ้าบวกถึงความสามารถในการกักเก็บประจุ ยิ่งมีความจุไฟฟ้ามากเท่าใดยิ่งเก็บประจุได้มากเท่านั้น ถ้าหากตัวเก็บประจุมีขนาดพื้นที่ขนาดมากกว่าระยะห่างระหว่างแผ่นขนาดมากๆ จะได้ว่าความจุไฟฟ้ามีค่าดังสมการ (10)

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (10)$$

ϵ_0 คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกค่าสภาระยอมสัมพัทธ์ (permittivity) ในสุญญากาศ มีค่า

$$8.854 \times 10^{-12} \text{ ฟาร์ดต่อเมตร } F/m$$

A คือ พื้นที่ของไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m^2)

C คือ ค่าความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟาร์ด (F)

d คือ ความหนาของสารไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นเมตร (m)

ในกรณีที่มีสารไดอิเล็กทริกวางอยู่ระหว่างแผ่นขาน ความจุไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าซึ่งเท่ากับค่าสภาระยอมสัมพัทธ์ (Relative permittivity) หรือที่เรียกว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) ของเซรามิก ดังสมการ 11

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} \quad (11)$$

เมื่อ ϵ_0 คือ ค่าสภาระยอมสัมพัทธ์ (Permittivity) ในสุญญากาศ โดยมีค่าประมาณ

$$8.854 \times 10^{-12} \text{ ฟาร์ดต่อเมตร } F/m$$

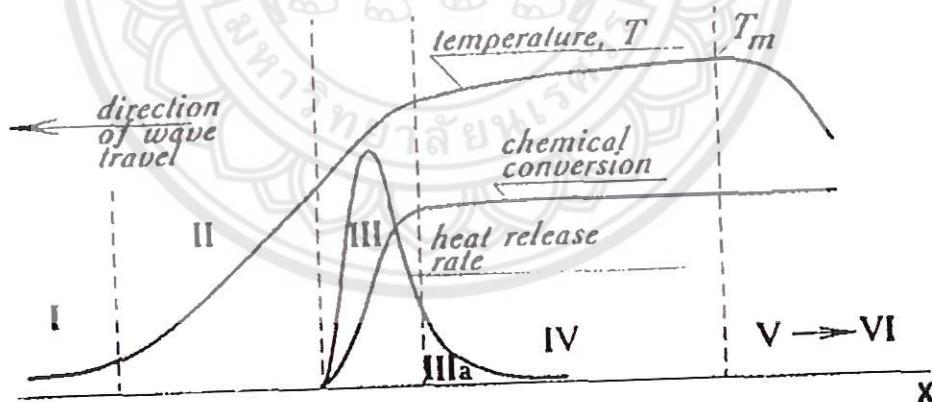
การมีสารไดอิเล็กทริกอยู่ในตัวเก็บประจุจะช่วยเพิ่มพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุให้สามารถสร้างตัวเก็บประจุขนาดเล็กแต่ความจุไฟฟ้าสูงได้ ความคงทนไดอิเล็กทริก (Dielectric strength) ความคงทนไดอิเล็กทริก เป็นสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินคุณภาพของไดอิเล็กทริกเป็นบริมาณที่บ่งบอกถึงความทนทานต่อความต่างศักย์ของไดอิเล็กทริก ความคงทนไดอิเล็กทริกมีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ไดอิเล็กทริกยังคงใช้งานได้ โดยปราศจากความเสียหายต่อความยาวหนึ่งหน่วย ถ้าวัสดุไดอิเล็กทริกถูกป้อนด้วยความค่าความค่างศักย์ที่สูงมากๆ อาจจะทำให้แฟกเตอร์สูญเสียพลังงาน (Energy loss factor) ถ้าป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าให้แก่สารไดอิเล็กทริกที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานเลย ศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบขยาย แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าศักย์ไฟฟ้าอยู่ 90 องศา แต่ในความเป็นจริงนั้น สำหรับไดอิเล็กทริกที่หัวไป มุมต่างเฟสจะน้อยกว่า 90 องศา เสมอ ถ้าให้ δ คือค่ามุมที่นำไปลบออกจาก 90 องศา ปริมาณ $\tan \delta$ จะหมายถึง แฟกเตอร์สูญเสียพลังงานในไดอิเล็กทริกของตัวเก็บประจุเมื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2.10 การเตรียมเซรามิกด้วยวิธีการการเผาไหม้

การใช้ประโยชน์จากการผลิตปล่องงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีในขั้นตอนการผลิต มีการใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อ Beketov และ Goldshmidt ได้ค้นพบ self-sustaining thermite reaction ซึ่งต่อมาได้ใช้หลักการจุดระเบิดของปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตอย่างมากมาย เช่น ในกระบวนการผลิตเทาเหล็ก การผลิตเฟอร์อัลลอย ฯลฯ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทฤษฎีการเผาไหม้ (combustion) ยุคใหม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยปฏิบัตมายังปี ค.ศ.1930-1940 สำหรับแก๊ส และปี ค.ศ.1950-1960 สำหรับของเหลว (ในปี ค.ศ.1967 ได้มีการค้นพบปรากฏการณ์จุดระเบิดของของแข็ง ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะได้ผลผลิตในสถานะของแข็ง และการพัฒนาวิธีการเผาไหม้บนพื้นฐานของ self-propagation high-temperature (SHS) ได้กระตุ้นให้เกิดการทดลองและการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาไหม้ของสารประกอบอนินทรีย์และวัสดุ อย่างกว้างขวาง ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ถูกนำไปเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการเผาไหม้ และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

กระบวนการเผาไหม้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง สำหรับวัสดุชั้นสูงและกระบวนการผลิตเพื่อการประยุกต์พลังงาน ในปัจจุบันการควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด อุณหภูมิ สัดส่วน และโครงสร้างของผลผลิตทำได้โดยการประยุกต์แนวคิดแผนใหม่ของทฤษฎีการเผาไหม้และโครงสร้างพลศาสตร์มหันภาค ของปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการทั่วไปของการเผาไหม้ ได้ดังรูปที่

11



รูปที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเผาไหม้ [31]

ช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิกิริยา ช่วงที่สอง เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยา ซึ่งช่วงนี้จะยังไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น แต่จะมีการถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่สาม เป็นช่วงที่มีความสำคัญ ต่อโครงสร้างของวัสดุ โดยจะมีการผลิตปล่องงานความร้อนของมวลเมื่อเกิดการจุดระเบิด และความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานี้จะแพร่ไปสู่ช่วงต้นของช่วงที่สี่ คือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical conversion) ส่วนที่กว้างที่สุดของช่วงนี้ คือ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเฟสและโครงสร้าง ของวัสดุ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างสุดท้ายและมีบทบาทสำคัญต่อสมบัติของวัสดุ

ในช่วงที่ห้าของกระบวนการ เป็นช่วงที่วัสดุเกิดการเย็นตัว และในช่วงนี้อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของวัสดุ ถ้าการเย็นตัวเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จะทำให้โครงสร้างของวัสดุที่สมดุล ดังนั้นในกระบวนการเผาใหม่ อัตราการให้ความร้อนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการผลิตปล่อยความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนคุณลักษณะของวัสดุที่ได้จะขึ้นอยู่กับไฟ โครงสร้างเงื่อนไข และอัตราการเย็นตัวของวัสดุ [31-33]

2.11 การซินเตอร์

การซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง

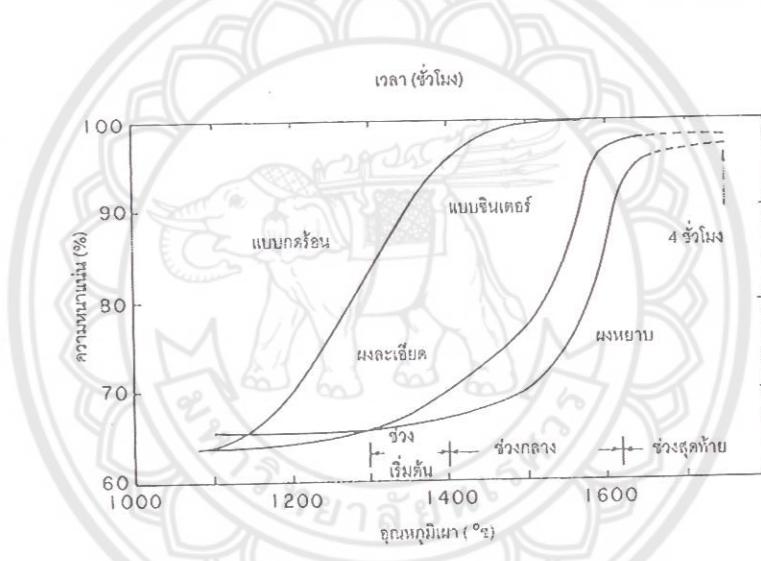
การซินเตอร์ (sintering) คือ กระบวนการทางความร้อนที่ทำใหอนุภาคเกิดการสร้างพันธะกันอย่างสมดุล โดยมีโครงสร้างหลักเป็นของแข็ง ที่พัฒนาจากการเคลื่อนย้ายมวลลักษณะ ต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในระดับของอะตอม การเกิดพันธะเชื่อมต่อกันดังกล่าวทำให้ระบบมีความแข็งแรงสูงขึ้นและมีพลังงานลดลง นอกจากนี้ยังอาจจะกล่าวได้ว่าการซินเตอร์นั้น หมายถึงการกำจัดรูพรุนที่อยู่ระหว่างอนุภาคผงเริ่มต้น โดยอาศัยการหดตัวขององค์ประกอบที่เข้มอยู่ติดกันแล้วเกิดการเติบโตไปด้วยกัน โดยมีการสร้างพันธะที่แข็งแรงระหว่างอนุภาคที่อยู่ติดกันขึ้นมากขึ้นตอนที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสภาพชิ้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป ไปเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยการยึดเกาะกันของเกรนต่างๆ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซินเตอร์ทั้งสิ้น แรงขับดันสำหรับการซินเตอร์นั้นได้มาจากกรดพื้นที่ผิวและพลังงานของพื้นผิวด้วยการใช้ของแข็งที่เข้มยึดกันโดยมีพลังงานของเกรนแบบของแข็ง-ของแข็ง (γsv) ที่ค่อนข้างต่ำเข้าไปแทนที่กลุ่มอนุภาคผงที่ยึดกันอยู่อย่างหลวมๆ ซึ่งจะมีพลังงานพื้นผิวแบบของแข็ง-ไอ (γsv) ที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้เองการผลิตเซรามิกส่วนใหญ่จึงนิยมใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดอนุภาคเล็ก เนื่องจากอนุภาคผงที่มีขนาดยิ่งเล็กเท่าไรก็จะยิ่งมีพื้นที่เลือกใช้อุปกรณ์ตั้งต้นที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ผิวมากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ระบบมีแรงขับดันสำหรับการซินเตอร์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ชิ้นงานสามารถเกิดการแน่นตัวได้ดี จึงมีความหนาแน่นสูง หรือทำให้สามารถใช้อุณหภูมิในการเผาที่ต่ำลงได้ [34]

การหดตัวของชิ้นงานเซรามิกขณะที่ทำการซินเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากการวัดขนาดหรือหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และเวลาในการเผา ดังเช่น ตัวอย่างของพฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (solid - state sintering) ที่ ๑ ไปด้วยดังรูปที่ 12 ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนหลักที่มีความควบคุมต่อเนื่องกันอยู่คือ

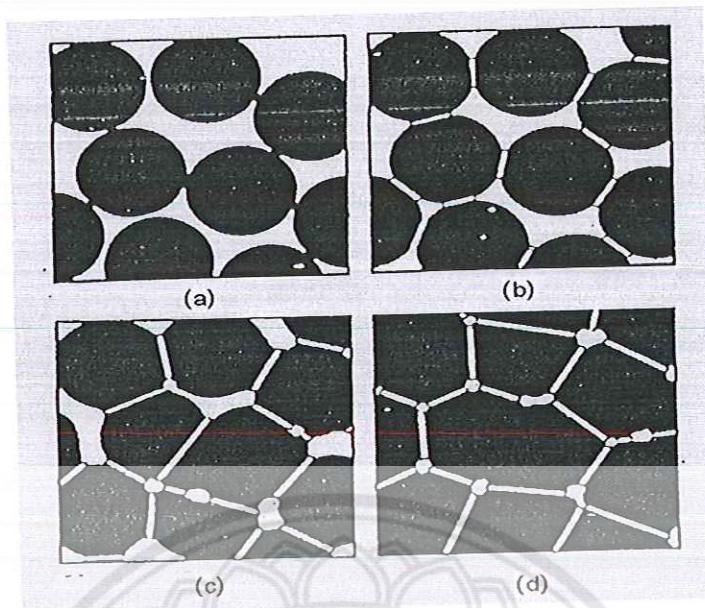
1. การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (initial sintering) จะเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวกันใหม่อีกครั้ง หนึ่งของอนุภาคผงภายในชิ้นงานและการเกิดพันธะที่แข็งแรง หรือคอ (neck) ขึ้นมาที่บริเวณจุดสัมผัส ระหว่างอนุภาคผง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานในช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ไปถึง 0.6 ได้ ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการที่อนุภาคผงมีการแพคตัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รูปที่ 13 (x) การซินเตอร์ช่วงส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการที่อนุภาคผงมีการแพคตัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รูปที่ 13 (x) การซินเตอร์ช่วงกลาง (intermediate sintering) เป็นช่วงที่ขนาดของคอเริ่มโตขึ้นและปริมาณของความพrun ใน

ขั้นงานจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอนุภาคเริ่มเข้ามาใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ขั้นงานเกิดมีการหดตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มมีเกรนและขอบเกรนเกิดขึ้นพร้อมกับมีการเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดมีการเติบโตของเกรนบางเกรนขึ้น ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องในขณะที่ช่องว่างของรูพ魯นจะเริ่มเกิดการเข้มต่อ กัน (พวกรูพ魯นเปิด) และจะสิ้นสุดพฤติกรรมนี้ในทันทีเมื่อรูพ魯นเกิดมีการแยกตัวหลุดออกไปอยู่ต่างหาก (พวกรูพ魯นปิด) การหดตัวของขั้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุด ในการซินเตอร์ช่วงกลางนี้ และอาจจะทำให้ความหนาแน่นสัมพันธ์ของขั้นงานมีค่าสูง(รูปที่ 13 (ค))

2. การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย(final stage sintering) เป็นช่วงที่รูพ魯นในขั้นงานเริ่มปิดตัวเอง ลงและค่อย ๆ ถูกกำจัดให้หมดไปจากขั้นงานอย่างช้า ๆ โดยอาศัยกลไกการแพร่ของอากาศจากรูพ魯น ออกตามแนวของขอบเกรน แล้วหลุดออกไปจากผิวของขั้นงาน ซึ่งจะทำให้ขั้นงานเกิดการแน่นตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเล็กน้อย ขนาดของเกรนจะเพิ่มขึ้นในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายนี้ รูปที่ 13 (ง)



รูปที่ 12 พฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็งทั่วๆ ไปในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา [27]



รูปที่ 13 พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (ก) อนุภาคนยีดกันอยู่แบบหลวมๆ หลังการอัดขึ้นรูป (ข) การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (ค) การซินเตอร์ปั่งกลาง และ (ง) การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย [34]

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว(liquid phase sintering)เป็นกระบวนการเผาซินเตอร์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งของวัสดุเกิดการหลอมเหลวขึ้นจนถ่ายสภาพไปเป็นของเหลวในระหว่างที่มีการซินเตอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตเซรามิก ด้วยการใช้อุณหภูมิเผาซินเตอร์ที่ต่ำลง เนื่องจากโดยปกติแล้ววัสดุพลาสติกเซรามิกส่วนใหญ่จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงมากบางชนิดอาจสูงถึงประมาณ 1300 องศาเซลเซียส ทำให้ต้องมีการใช้พลังงานที่สูงมากในการเผาซินเตอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และมีเวลาเผาอยู่ในกีประเทกที่สามารถใช้งานภายใต้เงื่อนไขนี้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารในภาชนะที่หลอมตัว กับภาชนะเองได้ง่าย อีกด้วย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเซรามิกเหล่านี้ที่อุณหภูมิต่ำลงด้วยการใช้สารช่วยหลอมหรือฟลักซ์ (fluxes) ซึ่งเป็นอนุภาคนยีดกันอยู่แบบหลวมๆ ที่เติมลงไปเพื่อทำหน้าที่ช่วยให้ขั้นตอนการหลอมเหลวที่ต่ำกว่าสารองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์มาก จึงเกิดเป็นเฟสที่เป็นของเหลวให้เคลื่อนย้ายที่ในระหว่างการซินเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กระบวนการซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลวมีอยู่สองระบบคือ

1. ระบบที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อขั้นงานได้รับความร้อนจนกระทั่งถึงอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นและคงสภาพอยู่ตลอดช่วงของการซินเตอร์และเมื่อขั้นงานเริ่มเย็นตัวลงเฟสที่เป็นของเหลวนี้จะเกิดการแข็งตัวแยกเฟสอยู่ในขั้นงาน

2. ระบบที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อขั้นงานได้รับความร้อนจนกระทั่งถึงอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นแล้วค่อยๆ หายไปซ้ำๆ ด้วยการละลายลงไปอยู่ในเมทริกซ์ของขั้นงาน

กระบวนการซินเตอร์ที่มีเฟสของเหลวประกอบด้วย 4 ระยะหลักดังนี้

1. ระยะที่อนุภาคมีการจัดเรียงตัวกันใหม่ (particle rearrangement stage) หลังจากที่มีการหลอมเหลวเกิดขึ้นอนุภาคของแข็งจะถูกแรงดันรูเล็กจากของเหลวตึงเข้าการกัน ทำให้ขั้นงานเกิดมีการทดสอบด้วยรูปแบบอกไปจากขั้นงาน

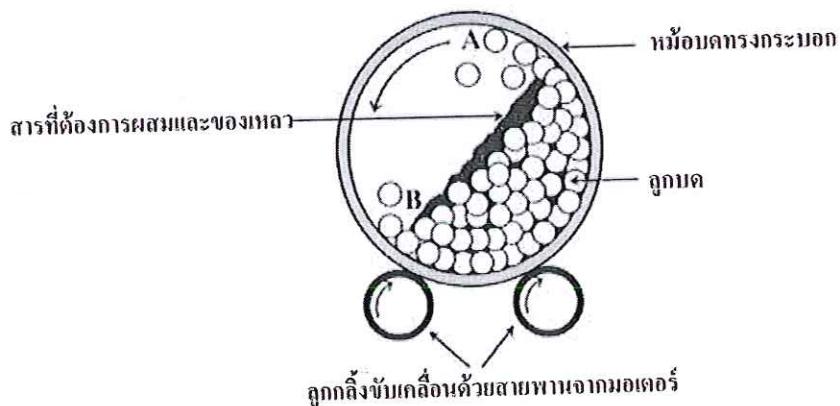
2. ระยะที่อนุภาคมีการแยกออกจากการกันแล้วเกิดการแตกตะกอนซ้ำ (dissolution reprecipitation stage) มีหลักการณ์ที่อนุภาคของแข็งสามารถละลายในเฟสที่เป็นของเหลวได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งความโถงของอนุภาคของแข็งและความดัน ณ จุดสัมผัสระหว่างอนุภาคของแข็งจะช่วยทำให้เกิดมีการแยกออกจากการกันของอนุภาคได้ เมื่อเกิดมีการละลายขึ้น ตัวถูกละลายจะแพร่เข้าสู่จุดที่มีความโถงตรงกันข้ามภายในโครงสร้างจุลภาค และเกิดการแตกตะกอนจนทำให้เกรนบริเวณดังกล่าวมีขนาดโตขึ้นซึ่งตัวที่แตกตะกอนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับอนุภาคของแข็งเริ่มต้นก็ได้แต่อาจจะเป็นตัวใหม่ที่มีองค์ประกอบของหงหงที่ได้มาจากเฟสที่เป็นของแข็งและที่เป็นของเหลวอยู่ร่วมกัน ซึ่งการแตกตะกอนในลักษณะดังกล่าวจะทำให้ปริมาณเฟสของเหลวที่เกิดขึ้นในระบบลดลงขณะที่มีการแตกตะกอน

3. ระยะที่ของเหลวมีการสมานลักษณ์ (liquid assimilation) ในบางกรณีของเหลวจะเข้าไปปะปนอยู่ร่วมกับเฟสที่เป็นของแข็งได้โดยตรงด้วยการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรืออาจจะเข้าไปแทรกอยู่ด้วยแรงกล จนทำให้เกิดการเป็นของแข็งที่อยู่ในรูปของสารละลายของแข็งที่เกิดจากการดูดซับของเหลวหรือเกิดเฟสใหม่ที่แตกผลึกมาจากการที่เกิดการหลอม

4. ระยะการเติบโตของเกรนในสถานะของแข็ง (solid state grain growth stage) เมื่อของเหลวถูกรีดออกมากจากอนุภาคที่อัดกันแน่น หรือมีการเพรช์มเข้าไปอยู่ภายในของแข็งจะทำให้เกิดมีขอบเกรนปรากฏขึ้นมา ซึ่งถ้าหากระบบยังมีการซินเตอร์อยู่ก็จะมีพฤติกรรมการเติบโตของเกรนเป็นขั้นตอนหลักที่ค่อยๆ ควบคุมพัฒนารูปแบบของกรอบซินเตอร์ต่อไป

2.12 กระบวนการบดย่อย ผสมด้วยลูกбол

กระบวนการเตรียมผงให้มีขนาดเล็กด้วยการหำ ให้อนุภาคขนาดใหญ่แตกออกโดยอาศัยแรงกล เรียกว่า การบด (Comminution) ซึ่งได้แก่ การบดหยาบ (Crushing) การบดละเอียด (Grinding) และการบดย่อย (Milling) กระบวนการเหล่านี้ได้รับความนิยมสูง ในการนำมาใช้เพื่อลดค่าขนาดอนุภาคลงเฉลี่ย ใช้ทำลายอนุภาคที่มีรูพรุน หรือสิ่งแปรปรวนฝังอยู่ข้างในให้แตกออกช่วยปรับพฤติกรรมการแยกของอนุภาคด้วยการลดขนาดของอนุภาคที่ใหญ่สุดลง ทا ให้จำนวนของอนุภาคขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ช่วยปรับปรุงรูปร่างของอนุภาค ช่วยแยกกลุ่มก้อนหรือกระจุกอนุภาคออกจากกัน และนอกจากนี้ยังสามารถมาใช้ในการสมอนุภาคผงต่างชนิดกันให้เกิดการผสมผسانเข้าไปพร้อมๆ กับการลดขนาดของอนุภาคกระบวนการบดย่อยด้วยลูกбол (Ball-milling) ที่เป็นเทคนิคนึงที่นิยมใช้ในปัจจุบันซึ่งเป็นกระบวนการบดย่อยผสมอนุภาคโดยอาศัยการหมุนหม้อ บด ซึ่งเป็นแท่งกลวง ทรงกระบอกมีฝาเปิด-ปิดอยู่ปลายด้านหนึ่ง ดังรูปที่ 2.14 สำหรับหม้อบดในระดับห้องปฏิบัติการมักหา ด้วยพลาสติก ที่สามารถ จัดเศษพลาสติกที่ป่นเปี้ย อนมากับการบดย่อย ได้ด้วยการเผาที่อุณหภูมิต่ำ ในหม้อบดจะมีการใส่สารที่จะทำ การบดผสมพร้อมลูกบลอบด (Grinding media) และสารที่ช่วยในการหล่อลื่น ลงเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของหม้อบด โดยจะต้องพยายามปรับอัตราส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้ในหม้อบด ให้ระบบทั้งชุดสามารถเกิดพฤติกรรมการบดย่อย กล่าวคือ ลักษณะของลูกบดจะต้องเคลื่อนที่ในลักษณะคล้ายกับตัวอักษร D โดยมีการเคลื่อนที่จากตา แน่น B ขึ้นไปจนถึงตา แน่น A และตกลงมากระแทกกับวัสดุด้านล่าง จากนั้นมีการหมุนเบียดเสียดกัน และมีการเลื่อนไหเดไป น วัฏจักรเข่นนี้ไปเรื่อยๆ ทا ให้อนุภาคของสารมีขนาดลดลง เนื่องจากการกระแทกของลูกบด ถูกขัดสะระหว่างหม้อบด และลูกบดกับผนังหม้อบดในขณะที่พฤติกรรมนี้จะเป็นขั้นส่วนของลูกบด หรือผนังของหม้อบดที่สึกกร่อนหลุดปะปนกอกมาด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะสามารถป้องกันได้ โดยการเลือกใช้ลูกบดที่มีคุณภาพสูง และหม้อบดที่สามารถ จัดออกได้ที่อุณหภูมิต่ำ เข่น หม้อบดพลาสติก เป็นต้น



รูปที่ 14 ภาพตัดขวางแสดงองค์ประกอบหลักของการบดย่อยด้วยลูกบด (Ball milling)

2.13 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope)

เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบทั้งแบบใช้แสงธรรมชาติและใช้รังสีแบบอื่น ๆ มีข้อจำกัดในการขยายภาพ เพราะกำลังขยายและกำลังแยกของเลนส์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ใช้อีกด้วย กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบสามารถมีกำลังแยกของขณะส่องดูวัตถุขนาดเล็กสุดได้เพียง $0.2 \text{ } \mu\text{m}$ ไมโครเมตรเท่านั้น ส่วนกำลังขยายรวมก็ไม่เกิน 2,000 เท่า จึงยังมองเห็นวัตถุภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้กว่าส่วนนั้นเป็นอะไรต่อมิได้มีการนำเอาอิเล็กตรอนซึ่งมีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นของแสงมาก เข้ามาใช้ในกล้องจุลทรรศน์แทนคลื่นแสง และใช้เลนส์แม่เหล็กแทนเลนส์กระเจรจ เรียกกล้องดังกล่าวว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นกล้องที่ใช้ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบพื้นผิวของเซลล์เนื้อเยื่อและวัตถุใด โดยทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์หรือวัตถุให้มีความเข้มข้น แตกต่างกัน [35]

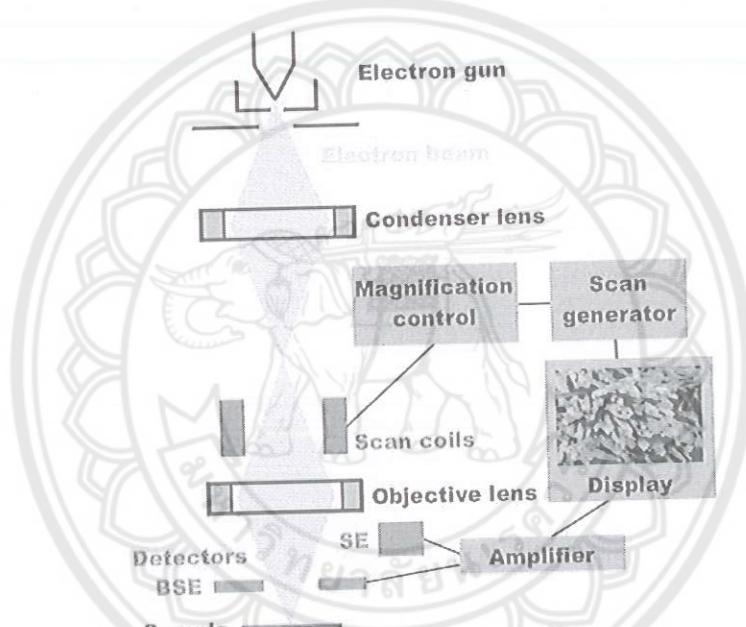
หลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron) จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) จะถูกเร่งด้วยศักย์ไฟฟ้าสูง ($1,000$ ถึง $3,000$ อิเล็กตรอนโวลท์ หรือมากกว่า) ที่สามารถปรับค่าได้จากนั้นจึงถูกดึงดูดลงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นอโนด (anode plate) ภายใต้ภาวะความดันสูญญากาศ $10^{-5} - 10^{-7}$ ทอร์ และมีชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ที่จะปรับลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้มีขนาด $10^{-5} - 10^{-7}$ ไมครอน ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดไฟกับสนผิวตัวอย่างพอดี และลำอิเล็กตรอนวัตถุ ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดไฟกับสนผิวตัวอย่างพอดี และลำอิเล็กตรอนที่ตัดกระบทผิวตัวอย่าง หรือตัวอย่างจะมีขนาดในช่วง 5 ถึง 200 นาโนเมตร โดยมีชุดขอควบคุมการส่องกราด (scan coil) ของลำอิเล็กตรอน ทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนบนผิwtตัวอย่าง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้โดยผ่านทางชุดควบคุม (control unit) ขณะที่ลำอิเล็กตรอนกระแทกผิwtตัวอย่าง จะเกิดอันตรกิริยา (interaction) ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับลำอิเล็กตรอนกระแทกผิwtตัวอย่างจะเกิดอันตรกิริยา (interaction) ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับลำอิเล็กตรอนกระแทกผิwtตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ขึ้นความลึกจากพื้นผิwtที่ระดับต่าง ๆ ทำอะตอมธาตุในวัตถุหรือตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ขึ้นความลึกจากพื้นผิwtที่ระดับต่าง ๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal) ชนิด ต่าง ๆ ออกมาน ซึ่งใช้ประโยชน์ใน การศึกษาลักษณะผิwtของตัวอย่างและวิเคราะห์ธาตุที่มีในตัวอย่างได้ตามลักษณะสัญญาณภาพที่ได้จากสัญญาณอิเล็กตรอนชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คือ

1. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Image, SEI) หรือเป็นอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ 3-5 อิเล็กตรอนโวลท์ เกิดที่พื้นผิwtระดับไม่มีลึก (ไม่เกิน 10 นาโนเมตร) โดยเกิดกับธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนที่ผิwtต่ำ
2. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscattered Electron Image, BEI) หรือเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่สูญเสียพลังงานให้กับอะตอมในชั้นงานเพียงบางส่วนและกระเจิงกลับออกมาน ซึ่ง

มีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื้นผิวระดับลึกกว่า 10 นาโนเมตร โดยเกิดได้ดีกับธาตุที่มีเลขอะตอมสูง

3. สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (X-Ray Image, XRI) ชนิดที่เป็นรังสีเอกซ์เฉพาะตัวเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนในระดับขั้นโคจรต่าง ๆ (K, L, M, \dots) ถูกกระตุ้น (excited) หรือได้รับพลังงานมากพอจนหลุดออกจากวงโคจรของ它 ทำให้อะตอมต้องรักษาสมดุลของโครงสร้างรวมภายในอะตอม โดยการดึงอิเล็กตรอนจากขั้นวงศ์โคจรถดไปเข้ามาแทนที่และต้องลดพลังงานส่วนเกินออกมายังรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานเท่ากับขั้นวงศ์โคจรที่ไปแทนที่ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเฉพาะในแต่ละธาตุตามระดับพลังงานของตัวอย่างได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ



รูปที่ 15 องค์ประกอบและหลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [35]

สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณภาพปราภูบันจอรับภาพได้โดยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการวัดให้เหมาะสมกับสัญญาณแต่ละชนิด โดยทั่วไปสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิใช้ตัวตรวจวัดชนิดพลาสติกเรืองแสง (Plastic scintillation detector) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนจะใช้ตัวตรวจวัดที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดรอยต่อพีเอ็น (PN junction detector) หรือตัวตรวจวัดชนิดโรบินสัน (Robinson detector) และในสัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์จะใช้หัวรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำประเททซิลิคอนลิตเทียม (lithium drifted silicon, Si(Li)) ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในการวิเคราะห์พลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะตัวซึ่งอุปกรณ์วิเคราะห์นั้นมีทั้งแบบช่องเดียว (Single Channel Analyzer, SCA) และอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (Multi Channel Analyzer, MCA)

2.14 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer)

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุพื้นฐานแบบไม่ทำลาย (non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอกซ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบโครงสร้างผลึก รังสีเอกซ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจการหล่อหลังสูง มีความยาวคลื่นสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 – 100 อังสตรอม การเกิดอันตราริยาของรังสีเอกซ์กับสารนั้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเหล่านี้เราจึงสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สารได้ดังนี้ [36]

1. ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุต่าง ๆ ในสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ใช้ศึกษาหาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
3. ใช้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก หรือโมเลกุลของสารด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์มีทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติจากการสลายตัวของนิวเคลียสราดกัมมันตรังสีและที่มนุษย์ผลิตขึ้นจากกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่ออัตโนมัติรับการกระตุนด้วยอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงวิ่งชนอะตอม ทำให้เกิดอันตราริยา ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนชั้นวางโครงต่าง ๆ ของอะตอมมีค่าสูงขึ้นเกิดภาวะเข้าสู่ปกติ โดยมวลของอะตอมไม่เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิน ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า “รังสี (Pulse) จากอะตอมทุกครั้งที่ได้รับการกระตุน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า “รังสีเอกซ์” ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด ตามกระบวนการของการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินจากอะตอมบริเวณชั้นโครงอิเล็กตรอน คือ

1. รังสีเอกซ์เฉพาะตัว มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานเดียว (monochromatic X-ray) เพราะเกิดจากการลดระดับพลังงานที่แน่นอน ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนหรือนุภาคที่มีประจุบวกอื่น ๆ หรือไฟฟอนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นในของอะตอม แล้วถ่ายโอนพลังงานให้อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนชั้นในวงโคจรได้รับพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของชั้นวางโครง ทำให้หลุดออกจากวงโคจรเกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนในชั้นวางโคจรชั้น ทำให้อัตโนมัติในภาวะที่ถูกกระตุนและลดระดับพลังงานลงสู่ภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรในชั้นถัดไปจะลดระดับพลังงานลงมาให้เท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของวงโคจรชั้นในด้วยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานิรภรรังสีเอกซ์ แล้วเข้ามาแทนที่ของวงโคจรชั้นใน พลังงานส่วนเกินนี้จะมีค่าเท่ากับความต่างระดับพลังงานยึดเหนี่ยวเฉพาะวงโคจรของอิเล็กตรอน และชนิดของธาตุนั้น ๆ จึงมีพลังงานเฉพาะค่า
2. รังสีแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่อเนื่องกระจายจากค่าต่ำสุด ถึงสูงสุด ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องเกิดจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนเข้าสู่สนามคู่

1020419



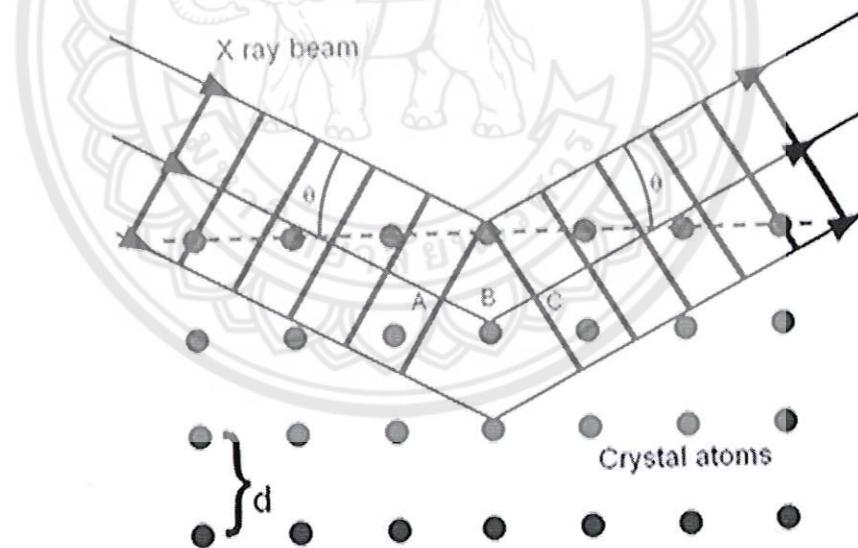
สำนักหอสมุด

ลอมบ์ (Coulomb field) บริเวณใกล้กับเคลือบ ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสถิตย์บริเวณดังกล่าวทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานอกจาก ก่อนที่อิเล็กตรอนปัจมุกิจะทำอันตรกิริยา กับสนามไฟฟ้าบริเวณใกล้กับเคลือบที่เกิดขึ้นใน

ประจุของอะตอม อิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานบางส่วน อันเนื่องจากการกระเจิงของอิเล็กตรอนดังนั้นพลังงานของรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้น จึงมีค่ากระเจ้ายต่อเนื่องจากพลังงานต่ำสุดถึงสูงสุดของอิเล็กตรอนปัจมุกิ ถ้าอิเล็กตรอนปัจมุกิมีพลังงานสูงพอที่จะกระตุนให้อิเล็กตรอนในวงโคจรขึ้นในของอะตอมหลุดออกจากกันจะเกิดรังสีเอกซ์เฉพาะค่าปั๊บช้อนอยู่กับสเปกตรัมของรังสีเอกซ์ต่อเนื่องด้วยเสมอ

การลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานี้ความพยายามลึกล้ำๆ ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่คายออกมานี้ ซึ่งความพยายามลึกล้ำที่สั้นที่สุดเกิดจากการที่อิเล็กตรอนถูกพัฒนาที่ได้รับมาทั้งหมดจากแหล่งกำเนิดโดยไม่ขึ้นกับชนิดของเป้าหมายที่ใช้

เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบผิวน้ำของผลึกโดยทำมุม θ บางส่วนของรังสีเอกซ์จะเกิดการกระเจิงด้วยด้วยขั้นของอะตอมที่ผิวน้ำ อีกส่วนหนึ่งของลำรังสีเอกซ์จะผ่านไปยังขั้นที่ 2 ของอะตอม ซึ่งบางส่วนจะกระเจิงและส่วนที่เหลือก็จะผ่านเข้าไปยังขั้นที่ 3 ของอะตอมดังรูปที่ 16



รูปที่ 16 แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของแบร์ก [36]

ถ้าอะตอมในผลึกมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบและมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่าๆ กัน ลำรังสีเอกซ์ที่ผ่านเข้าไปในแต่ละขั้นของอะตอมจะเกิดการเลี้ยวเบนเป็นลำชานานกัน สิ่งสำคัญในการเกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับภาวะ 2 ประการ คือ

1. รังสีที่ตกกระทบ รังสีเลี้ยวเบน และเส้นตั้งฉากกับผิวน้ำจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

2. ระยะห่างระหว่างชั้นของอะตอมคร้มค่าใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ เมื่อปี ค.ศ. 1912 แบรกก์ได้ยิงลำรังสีเอกซ์แคนบ ๆ กระทบผิวน้ำผลึกเป็นมุม θ เพื่อให้เกิดการเลี้ยวเบนและการกระเจิงเมื่อกีดอันตรกิริยา กับอะตอม O , P และ R ถ้า

$$SQ + QT = n\lambda \quad (12)$$

เมื่อ n คือ จำนวนเต็ม รังสีที่กระเจิงจะอยู่ในเฟสที่ OCD ผลึกจะทำหน้าที่สะท้อนรังสีเอกซ์ จะเห็นว่า

$$SQ = QT = d \sin\theta \quad (13)$$

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของผลึก เขียนสนการใหม่ได้ว่า

$$n\lambda = 2d \sin\theta \quad (14)$$

เรียกสมการนี้ว่า สมการของแบรกก์ (Bragg's equation) ซึ่งมีประโยชน์มาก สำหรับการศึกษาที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ เช่น สารที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเดียว (single crystal) และผลึกเชิงซ้อน (polycrystalline) เพราะในสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการเรียงตัวของอะตอมเป็นลักษณะเฉพาะ เมื่อเราทราบถึงค่ามุมที่เกิดการเลี้ยวเบนไปของรังสีเอกซ์เมื่อกีดกับอะตอมของสาร เราจะทราบถึงระยะห่างระหว่างแต่ละอะตอมของสารนั้น ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์หาชนิดของสาร (qualitative analysis) รวมไปถึงสมบัติทางกายภาพของสารนั้น ๆ อีกด้วย การคำนวณหาค่าคงที่แลตทิช c , a และค่าอัตราส่วน c/a สามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่องเอกซเรย์ดิฟเพρεραγχν และจากสมการที่ (15)

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (15)$$

ในระบบเทหะไก้นั้น ค่าแลตทิช a มีค่าเท่ากับแลตทิช b แต่ไม่เท่ากับแลตทิช c ($a = b \neq c$) ดังนั้น จากสมการที่ (15) เขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (16)$$

หรือ

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = (h^2 + k^2) + \frac{l^2}{(c/a)^2} \quad (17)$$

สำหรับเดดไฮดานาสามารถคำนวณหาค่าอัตราส่วน c/a ได้โดยนำค่า d-spacing d_{002} และ d_{200} มาคำนวณตามสมการ (18)

$$c/a = \frac{d_{002}}{d_{200}} \quad (18)$$

2.15 การหาความหนาแน่น (Density)

ความหนาแน่น หมายถึง ค่ามวลต่อปริมาตรของวัสดุ ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ หน่วยของค่าความหนาแน่นสามารถเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร ,กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ,ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต , กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นต้น สำหรับส่วนที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้จะใช้ในหน่วยของกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเชรามิกอย่างยิ่งคือ การอาศัยค่าความหนาแน่นเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการอัดแน่นตัวของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณนั้นยังสามารถนำไปสู่การหาค่าความพรุนของวัสดุได้อีกด้วย

การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานนั้นอาศัยหลักการของอาร์คิมิดีส์ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อจุ่มของแข็งลงในของเหลวจะมีแรงพยุงเกิดขึ้นบนของแข็งนั้น โดยแรงพยุงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของของแข็ง” วิธีการนี้ทำได้โดยการหาค่ามวลของวัตถุในอากาศ และขณะที่จุ่มอยู่ใน [44]

$$\text{ความหนาแน่น } \rho = \frac{W_a}{W_a - W_{fl}} \cdot \rho_{fl} \quad (19)$$

เมื่อ	ρ	ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
	ρ_{fl}	ค่าความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
	W_a	น้ำหนักแห้งของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัม
	W_{fl}	น้ำหนักแห้งของชิ้นงานในของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม

ส่วนการหาความหนาแน่นของของเหลวในกรณีที่ทราบปริมาตรที่แน่นอนของของแข็งไปสามารถหาได้จาก

$$\rho_{fl} = G / V \quad (20)$$

โดยที่	G	คือ แรงพยุงที่เกิดขึ้นกับของแข็ง (หน่วยเป็นกรัม) หาได้จากน้ำหนักของชิ้นงานในอากาศลบด้วยน้ำหนักของชิ้นงานในของเหลว
	V	คือ ปริมาตรของของแข็งที่จุ่มลงในของเหลว มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

สำหรับการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density): ρ_r] นั้น สามารถคำนวณหาได้ตามสมการที่ (21)

$$\rho_r(\%) = \left(\frac{\rho_b}{\rho_{fl}} \right) \times 100 \quad (21)$$

เมื่อ ρ_r	คือ ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
ρ_b	ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ρ_{fl}	ค่าความหนาแน่นทฤษฎีมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

2.16 การหาค่าคงที่การแพร่ (diffuseness ; γ)

ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริกนั้นจะขึ้นกับอุณหภูมิ ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยกฎครี-ไวส์ (Curie-Weiss law) [10]

$$\frac{1}{\varepsilon_r} - \frac{1}{\varepsilon_m} = C^{-1}(T - T_m)^\gamma, (T > T_m) \quad (22)$$

โดยที่ γ คือ ค่า diffuseness

ε_r คือ ค่าคงที่ไออิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง

ε_m คือ ค่าคงที่ไออิเล็กทริกที่อุณหภูมิครี

T_m คืออุณหภูมิครีเมื่อน่วยเป็นองศาเซลเซียส

T คืออุณหภูมิหลังจากการเปลี่ยนเฟسمีน่วยเป็นองศาเซลเซียส

C คือค่าคงที่ของครี-ไวส์ (Curie-Weiss constant)

ซึ่งหากค่า $\gamma = 1$ จะเรียกว่าเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบปกติ(normal ferroelectrics) และถ้า $1 < \gamma < 2$ จะเรียกว่าแล็คเซอร์เฟอร์โรอิเล็กทริก (relaxor ferroelectrics)



บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1. บิสมัทออกไซต์ (Bi_2O_3) ความบริสุทธิ์ 99%
2. โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) ความบริสุทธิ์ 99%
3. โพแทสเซียมไนเตรต (KNO_3) ความบริสุทธิ์ 99%
4. ไททาเนียมไดออกไซต์ (TiO_2) ความบริสุทธิ์ 99%
5. ไนโอลูบิเมอกไซต์ (Nb_2O_5) ความบริสุทธิ์ 99%
6. แบร์เรียมคาร์บอเนต (BaCO_3) ความบริสุทธิ์ 99%
7. แคลเซียมไนเตรต ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4(\text{H}_2\text{O})$) ความบริสุทธิ์ 99%
8. เชอร์โคเนียมไดออกไซด์ (ZrO_2) ความบริสุทธิ์ 99%
9. ไกลชีน ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$)
10. สารละลายน้ำยาเอทานอล (Ethanol absolution) ความบริสุทธิ์ 99.7%

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสาร

1. เครื่องซั่งแบบละเอียด satorius AG GOTTINGEN type Fabr-Nr (ควบคุมการทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ซั่งมวลได้มากที่สุดไม่เกิน 310 กรัม โดยมีความละเอียด 0.001 กรัม
2. ตู้อบสารของยีห้อ Memmert D06057 Model 100 อุณหภูมิในการอบสูงสุด 200 องศาเซลเซียส
3. กระปองพลาสติกที่ใช้ในการผสมสารทำด้วยโพลีเมอร์และมีฝาปิดสนิท โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ความสูง 10.7 เซนติเมตร
4. เม็ดบดด้วยทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร (ใช้ในจำนวน 250 เม็ด)
5. เครื่องผสมแบบบดด้วยแบบลูกบด (Ball milling)
6. Hot plate สำหรับใช้ในการทำให้สารระเหยออก
7. Magnetic stirrer สำหรับคนสารให้เข้ากัน
8. ข้อมตักสาร
9. ปีกเกอร์ขนาด 1000 ซีซี
10. แม่พิมพ์ (Punch and die) ใช้ในการขีนรูปเชรามิก
11. กระดาษฟอยล์ (Foil)

12. เครื่องอัดไฮดรอลิกสำหรับขันรูปเซรามิก อัดแรงดันได้สูงสุด 1000 Kg/cm^3
13. เตาเผาสาร Eurotherm อุณหภูมิสูงสุดในการเผา 1700 องศาเซลเซียส
14. เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยงเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer)
15. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกล้อง (SEM)
16. เครื่องวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (Aligent LCR Meter)
17. เครื่องวัดวงอิสเทอเรชั่น

วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1

1. การเตรียมผงผลึก BNT-BKT-KNN

1.1. ชั้งสารตั้งต้นคือ บิสมัทออกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต โพแทสเซียมไนเตรต “ไทยเนียมไดออกไซด์” ในนำไปเปลี่ยนออกไซด์ ชั้งตามอัตราส่วนโดยมวลที่ได้จากการคำนวณ

1.2. นำสารที่ผ่านการซึ่งจากข้อ 1 มาทำการผสมตามชนิดของผงผลึกที่ต้องการในกระป๋องพลาสติกที่มีเม็ดบลอกขนาด 7 มิลลิเมตร จำนวน 250 เม็ด โดยเติมເອຫານລິນບຣິມານ 200 มີლລິລິຕິຮັດສິ່ງຈະຊ່ວຍໃນการผสมสารให้ผสมกันดียิ่งขึ้น จากนั้นนำไปบดຢ່ອຍບນເຄື່ອງບດเป็นเวลา 24 ชົ້ວໂມງ

1.3. เมื่อบด 24 ชົ້ວໂມງแล้ว จากนั้นนำสารที่อยู่ในกระป๋องบดแต่ละกระป๋องทำการเหลวໃນຕະແກງລວດທີ່ວ່າງອູ່ບັນບຶກເກອຮ່າພໍວແຍກຂອງທີ່ຜົມອອກຈາກເມັດບຸດ ໂດຍກາຍແກນນີ້ຈະທຳເປັນຫຼຸດຕາມชนิดຂອງสาร ແລ້ວຈຶ່ງນຳສານແຕ່ລະຫຼຸດທຳການແຍກເຂົາເວຫານລອອກໄດ້ໃຫ້ Hot plat

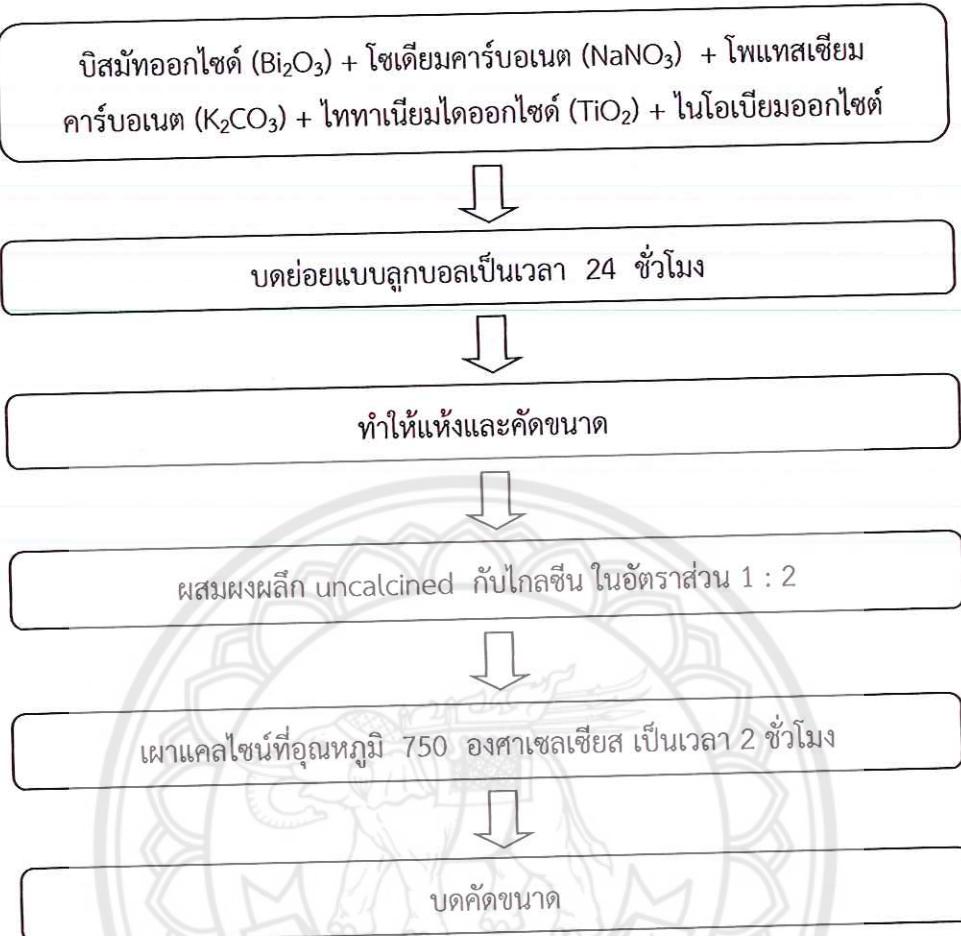
1.4. เมื่อทำการແຍກເຂົາເວຫານລອອກຈາກสารແລ້ວຈຶ່ງທຳການອົບໃນເຕາບໂດຍໃໝ່ອຸນຫຼຸມ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชົ້ວໂມງ

1.5. นำสารที่ผ่านการອົບແໜ່ງແລ້ວมาທຳການບດຄ່າຍ່າງຫຍາບໂດຍໃໝ່ຄຽກຫຍກ (Agate) ເພື່ອຄັດຂາດແລະເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົມຜັກທີ່ມີຂາດທີ່ສໍາ່າເສນອ

1.6. นำຜົມຜັກທີ່ຜົນການບດຄ່າຂາດໃນແຕ່ລະຫຼຸດມາບຜົມໄກລເຊື່ນ ໂດຍໃໝ່ອັຕຣາສ່ວນ 1:2

1.7. นำสารທີ່ບັດຜົມໄກລເຊື່ນແຕ່ລະຫຼຸດນຳມາໃສ່ໃນ Crucible ເປີດຝາຈາກນັ້ນนำไปເພາະແຄລໃໝ່ໃນເຕາໂດຍໃໝ່ອຸນຫຼຸມ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชົ້ວໂມງ ອັຕຣາການພື້ນລົງຂອງອຸນຫຼຸມ 5 องศาเซลเซียสຕ່ອນາທີ

1.8. นำຜົມຜັກທີ່ໄດ້ມາບດຄ່າຂາດ



รูปที่ 17 แผนผังขั้นตอนการเตรียมผงผลึก BNT-BKT-KNN [10]

2. การเตรียมผงผลึก BCTZ

- 2.1. ซึ่งสารตั้งต้นคือ แบเรียมคาร์บอเนต แคลเซียมไนเตรต ไททาเนียมไดออกไซด์ เชอร์โคเนียมไดออกไซด์ ซึ่งตามอัตราส่วนโดยมวลที่ได้จากการคำนวณ
- 2.2. นำสารที่ผ่านการซึ่งจากข้อ 1 มาทำการผสมตามชนิดของผงผลึกที่ต้องการในกระป๋องพลาสติกที่มีเม็ดบลลขนาด 7 มิลลิเมตร จำนวน 250 เม็ด โดยเติมเอทานอลในปริมาณ 200 มิลลิลิตร ซึ่งจะช่วยในการผสมสารให้สมกันดียิ่งขึ้น จากนั้นนำไปบดย่อยบนเครื่องบดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- 2.3. เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้ว จากนั้นนำสารที่อยู่ในกระป๋องบลลแต่ละกระป๋องทำการเทลงในตะแกรง漉漉ที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อแยกของที่ผสมออกจากเม็ดบลล โดยการแยกนี้จะทำเป็นชุดตามชนิดของสาร แล้วจึงนำสารแต่ละชุดทำการแยกเอาเอทานอลออกโดยใช้ Hot plate
- 2.4. เมื่อทำการแยกเอทานอลออกจากสารแล้วจึงทำการอบในเตาอบโดยใช้อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง

- 2.5. นำสารที่ผ่านการอบแห้งแล้วมาทำการบดอย่างหยาบโดยใช้ครกหยก (Agate) เพื่อคัดขนาดและเพื่อให้ได้ผงผลึกที่มีขนาดที่สม่ำเสมอ
- 2.6. นำผงผลึกที่ผ่านการบดคัดขนาดในแต่ละชนิดมาบดผสมไกลซีน โดยใช้อัตราส่วน 2.7. นำสารที่บดผสมไกลซีนแต่ละชนิดนำมาใส่ใน Crucible เปิดฝาจากนั้นนำไปเผาแคลไซซ์นในเตาโดยใช้อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที
- 2.8. นำผงผลึกที่ได้มานับคัดขนาด



รูปที่ 18 แผนผังขั้นตอนการเตรียมผงผลึก BCTZ [38]

ตอนที่ 2 การเตรียมเซรามิก (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ

1. ทำการเตรียมเซรามิก (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ โดยที่ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08$ และ 0.1 ตามลำดับ โดยการนำผงผลึก BNT-BKT-KNN และ BCTZ ที่ได้จากการเผาแคลไชน์ จากตอนที่ 1 มาผสมกันตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในกระป๋องพลาสติกที่มีเม็ดบล็อกขนาด 7 มิลลิเมตร โดยเติมเอทานอลในปริมาณ 200 มิลลิลิตร และผสม PVA ลงไปเป็นปริมาณร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก จากนั้นทำการปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปบดโดยยอบเครื่องบดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
2. เมื่อครบ 12 ชั่วโมงแล้ว จากนั้นนำสารที่อยู่ในกระป๋องบล็อกแต่ละกระป๋อง ทำการเทลงในตะแกรง漉漉ที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อแยกของที่ผสมออกจากเม็ดบล็อก โดยการแยกนี้จะทำเป็นชุดตามชนิดของสาร แล้วจึงนำสารละชุดทำการแยกเอทานอลออกโดยใช้ Hot plate และนำไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. นำสารที่อบเสร็จในแต่ละชนิดมาบดย่อยอย่างหยาบโดยใช้ครกหยก (Agate) เพื่อคัดขนาดเพื่อให้ได้ผงผลึกที่มีขนาดที่สม่ำเสมอ
4. จากนั้นนำผงผลึก (1-x)(BNT-BKT-KNN)-xBCTZ โดยที่ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08$ และ 0.1 ที่ผสม PVA และผ่านการบดย่อยเพื่อคัดขนาด มาทำการอัดขึ้นรูปให้เป็นรูปเหลี่ยมทรงกระบอกโดยใช้แม่พิมพ์โลหะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยใช้ผงผลึก (1-x)(BNT-BKT-KNN)-xBCTZ ในปริมาณ 1.2 กรัม ในการอัดขึ้นรูป 1 ครั้งต่อหนึ่งชนิดของสาร โดยใช้ค่าความดันในการอัดขึ้นรูป 80 MPa
5. นำชิ้นงานแต่ละชนิดที่ผ่านการขึ้นรูปมาเรียงไว้ในถ้วยอะลูминิ婭ที่มีฝาปิด โดยทำการจัดเรียงเป็นชั้นๆ ในแต่ละชั้นจะมีการนำสารตั้งต้นที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ กบบนเม็ดเซรามิกเพื่อสร้างบรรยากาศของตะกั่วล้อมรอบมีเดเพื่อลดการระเหยของตะกั่ว จากนั้นจะนำผงอะลูминิกบันทับอีกครั้ง
6. ทำการเผาเซรามิกที่อุณหภูมิระหว่าง $1075-1175$ องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที
7. นำเซรามิก ที่ผ่านการเผาเซรามิกท่อรีบีเพื่อทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางไฟฟ้า



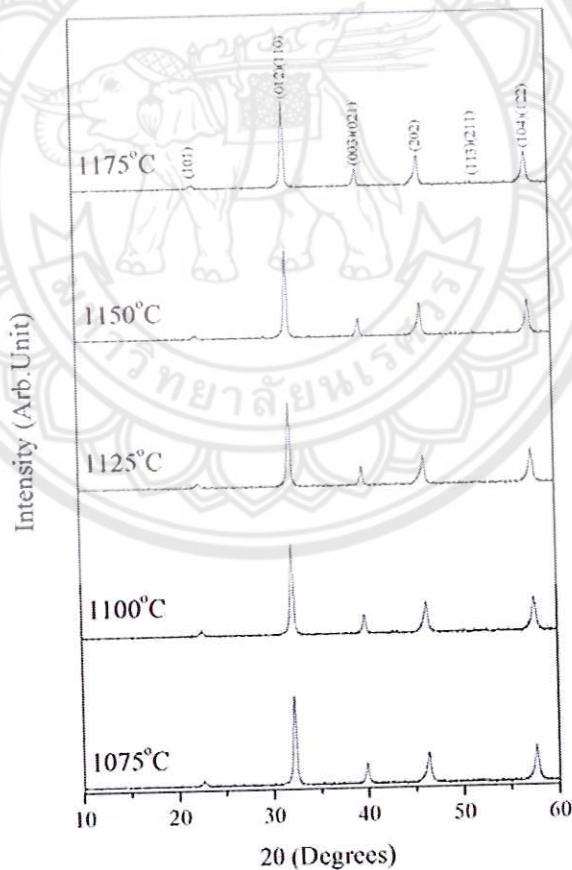
รูปที่ 19 แผนผังขั้นตอนการเตรียมเซรามิก $(1-x)BNT-BKT-KNN-xBCTZ$

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

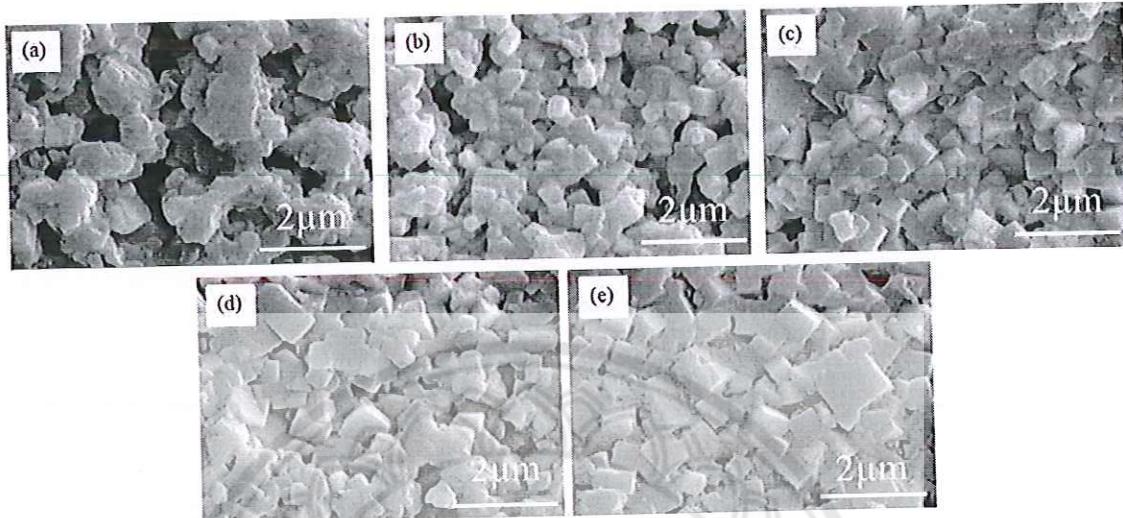
4.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี (X-ray diffractrometer : XRD) ของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ

หลังจากสังเคราะห์ผงผลึก BNT-BKT-KNN และ BCTZ ที่บริสุทธิ์ด้วยวิธีการเผาใหม่ นำผงผลึกดังกล่าวมาสมกันตามอัตราส่วน (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ จากนั้นทำการอัดขึ้นรูปเป็นเม็ดนำไปเผาที่อุณหภูมิชินเตอร์ระหว่าง 1075-1175 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำเซรามิกที่ผ่านการขันเตอร์มาตรวจสอบโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี ซึ่งผลการทดลองแสดงในรูปที่ 20 พบว่าเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ แสดงโครงสร้างเฟสแบบเพอร์ร็อฟไกต์ที่บริสุทธิ์ในทุกตัวอย่าง (ตารางที่ 1)



รูปที่ 20 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ
ที่ขันเตอร์ระหว่าง 1075 – 1175 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
อัตราการขันลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

4.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope)



รูปที่ 21 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ ขั้นเตอร์ที่อุณหภูมิ (a) 1075, (b) 1100, (c) 1125, (d) 1150, (e) 1175 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

จากการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่ โดยซินเทอร์ที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ 1075-1175 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 21 พบว่าที่อุณหภูมิขั้นเตอร์ 1075 องศาเซลเซียส (รูปที่ 21(a)) เซรามิกแสดงรูปรุนทดแทนใหญ่จำนวนมากและเซรามิกผนึกตัวยังไม่ดี เมื่ออุณหภูมิขั้นเตอร์สูงขึ้นพบว่ารูปรุนเริ่มลดลงและเกรนเซรามิกผนึกตัวดีมากขึ้น (รูปที่ 21 (b)) รูปรุนเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดและเกรนเซรามิกผนึกตัวกันอย่างหนาแน่นที่อุณหภูมิขั้นเตอร์เท่ากับ 1125 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิขั้นเตอร์สูงกว่า 1125 องศาเซลเซียสของเกรนเริ่มไม่ชัดเจนเนื่องจากเกรนเริ่มมีการหลอม (รูปที่ 21 (d), (e)) ขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิขั้นเตอร์เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ ชิ้นเตอร์ที่ อุณหภูมิระหว่าง 1075 – 1175 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิชิ้นเตอร์ (°C)	ร้อยละความบริสุทธิ์	ขนาดเกรนเฉลี่ย (μm)
1075	100	-
1100	100	0.87
1125	100	0.93
1150	100	0.96
1175	100	1.14

4.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ

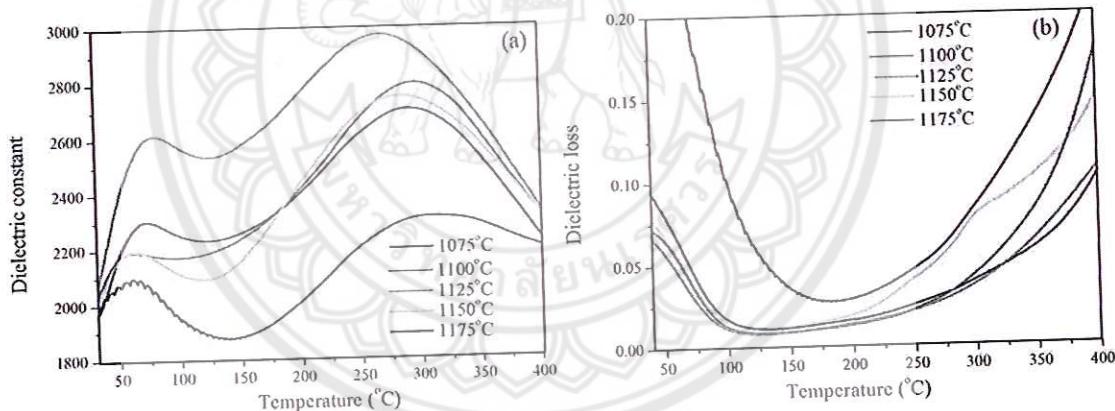
นำเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ ที่ผ่านกระบวนการชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1075-1125 องศาเซลเซียส มาทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความหนาแน่น และร้อยละการหดตัวเชิงเส้น พบว่าค่าความหนาแน่นของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชิ้นเตอร์เพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิ 1125 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิชิ้นเตอร์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ร้อยละการหดตัวเชิงเส้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิลดลงเมื่ออุณหภูมิชิ้นเตอร์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ร้อยละการหดตัวเชิงเส้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิชิ้นเตอร์เพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียสจากนั้นลดลงเมื่ออุณหภูมิชิ้นเตอร์เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าความหนาแน่นและร้อยละการหดตัวของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1075-1175 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิชิ้นเตอร์ (°C)	ความหนาแน่น (g/cm ³)	ร้อยละการหดตัว (%)
1075	4.91	14.3
1100	5.03	14.6
1125	5.50	17.2
1150	5.09	17.3
1175	5.01	15.8

4.4 ผลการวิเคราะห์สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ

สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1075-1175 องศาเซลเซียส วัดที่ความถี่ 1 kHz แสดงในรูปที่ 22 พบว่าเส้นกราฟค่าคงที่ไดอิเล็กทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงความโค้งเป็น 2 ช่วงในทุกตัวอย่าง โดยการเปลี่ยนแปลงความโค้งช่วงแรกแสดงถึงการเปลี่ยนเฟสจากเฟรโรอิเล็กทริกไปเป็นแอนติเฟรโรอิเล็กทริก ที่อุณหภูมิประมาณ $\sim 70^\circ\text{C}$ เรียก ความโค้งช่วงที่สองเกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 280°C ซึ่งแสดงการเปลี่ยนเฟสจากแอนติเฟรโรอิเล็กทริกไปเป็นพาราอิเล็กทริก โดยเรียกอุณหภูมิดังกล่าวว่าอุณหภูมิคีรี (Curie temperature; T_c) และการเปลี่ยนแปลงค่าของ T_p ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง (ϵ_r) และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคีรี (ϵ_m) เพิ่มขึ้น ค่าของ T_p , ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง (ϵ_r) และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคีรี (ϵ_m) เพิ่มขึ้นไปจนถึง 1125 องศาเซลเซียส จากนั้นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สำหรับค่า T_c และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ($\tan \delta$) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิคีรี มีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นไปจนถึง 1125 องศาเซลเซียส จากนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3



รูปที่ 22 สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ

a) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและ b) ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก

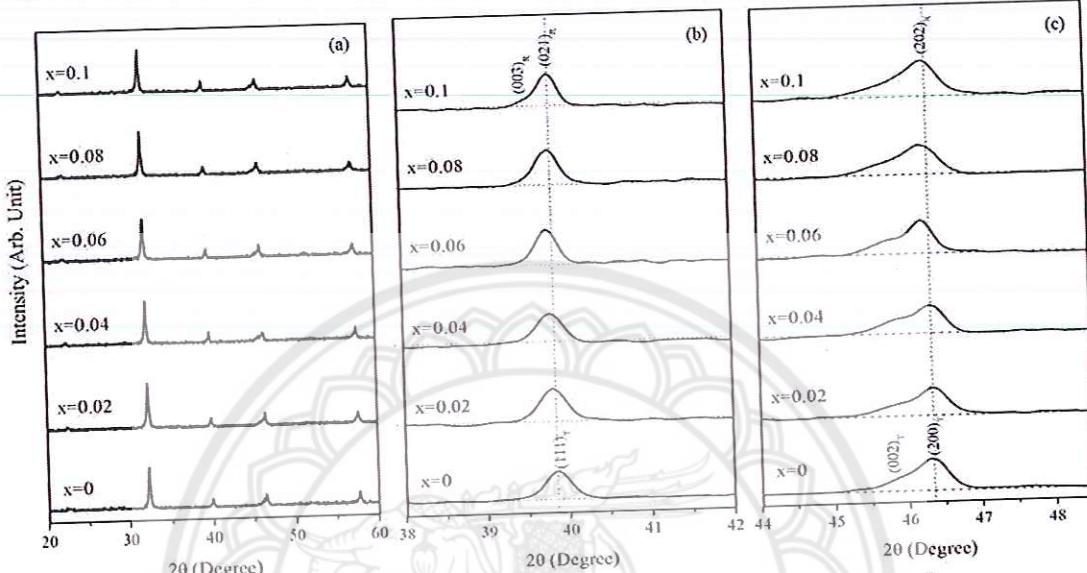
ตารางที่ 3 แสดงอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก (0.94)[BNT-BKT-KNN]-0.06BCTZ

อุณหภูมิชินเตอร์ (°C)	อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส (°C)	ε_r	$\tan \delta$ at T_r	ε_{max}	$\tan \delta$ at T_c
T_p	T_c				
1075	67.2	311.6	1873	0.3373	2311
1100	68.7	301.1	2022	0.0616	2796
1125	72.3	280.1	2281	0.0545	2963
1150	64.2	288.1	2095	0.0711	2749
1175	66.3	298.7	1986	0.0906	2699

4.5 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี (X-ray diffractrometer : XRD) ของเซรามิก (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ

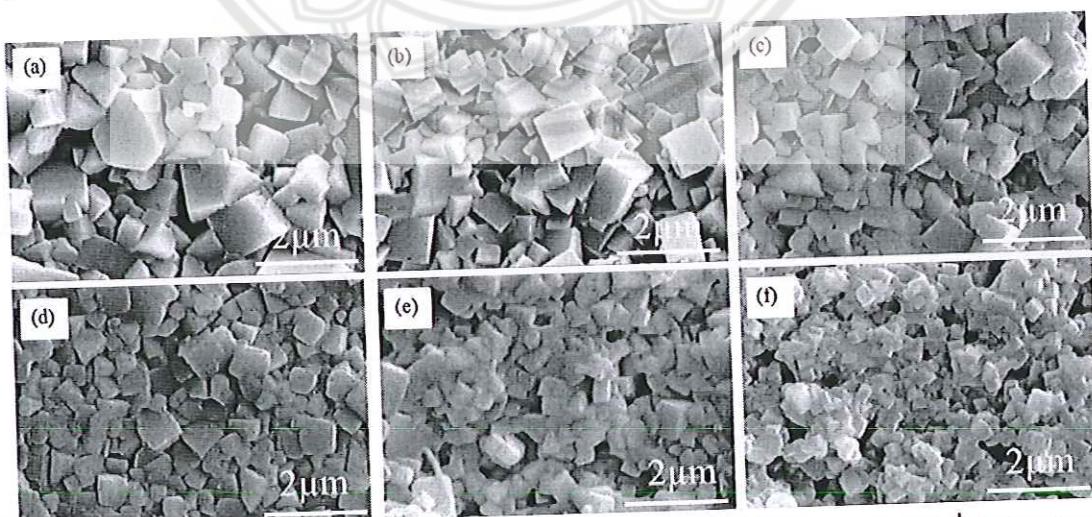
นำผงผลึก BNT-BKT-KNN และ BCTZ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาให้มีมาสสมกันตามองค์ประกอบ (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ โดยที่ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1$ จากนั้นทำการอัดขึ้นรูปเป็นเม็ดแล้วนำไปเผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1125°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำเม็ดเซรามิก (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ ที่ผ่านการชินเตอร์แล้วมาทำการตรวจสอบโครงสร้างผลึก ด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสี พบร้าเซรามิก (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ แสดงโครงสร้างเฟสแบบเพอร์อฟไกท์ที่บริสุทธิ์ในทุกตัวอย่าง โดยปกติลักษณะเฉพาะของโครงสร้างรวมโดยยึดรัลจะแสดงพีคคู่ของรูนาบ $(003)/(021)_R$ และพีคเดียวของรูนาบ $(202)_R$ ที่มุม $\sim 40^\circ$ และ $\sim 46^\circ$ ตามลำดับ ในขณะที่รูนาบ $(003)/(021)_R$ และพีคเดียวของรูนาบ $(202)_R$ ที่มุม $\sim 40^\circ$ และ $\sim 46^\circ$ ตามลำดับ ในขณะที่ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างเททระโนนล จะแสดงพีคเดียวของรูนาบ $(111)_T$ ที่มุม $\sim 40^\circ$ และแสดงพีคคู่ของรูนาบ $(002)/(200)_T$ ที่มุม $\sim 46.5^\circ$ [10] ที่ปริมาณ $x=0$ พบร้าเซรามิกแสดงโครงสร้างแบบเททระโนนลโดยที่มุม $\sim 40^\circ$ และพีคเดียวของรูนาบ $(111)_T$ ที่มีความสมมาตร และที่มุม $\sim 46^\circ$ และแสดงพีคคู่ของรูนาบ $(002)/(200)_T$ ดังแสดงในรูปที่ 23 (b) และ (c) เมื่อ $0 < x \leq 0.04$ พบร้าเซรามิกยังคงแสดงพีคเดียวที่สมมาตรของรูนาบ $(111)_T$ และแสดงพีคคู่ของรูนาบ $(002)/(200)_T$ โดยพีคกราฟดังกล่าวมีการเลื่อนไปที่มุมต่ำ ที่ปริมาณ $x=0.06$ พีคกราฟที่รูนาบ $(111)_T$ แสดง ความไม่สมมาตรโดยมีการเบี้ยวทางซ้ายและพีคกราฟที่รูนาบ $(002)/(200)_T$ ยังคงแยกเป็นพีคคู่อย่างชัดเจน โดยสันนิษฐานว่าเซรามิกมีโครงสร้างเฟสแบบสมรรถะท่วงเททระโนนลและรวมโดยยึดรัล และที่ปริมาณ $x > 0.06$ พีคกราฟที่รูนาบ $(111)_T$ เกิดการเบี่ยงเบี้ยน ซึ่งคาดว่าจะแยกเป็นพีคคู่ของ

ระยะ $(003)/(021)_R$ ในขณะที่พีคคู่ของระยะ $(002)/(200)_T$ เริ่มรวมเข้าหากันเป็นพีคเดียวของระยะ $(202)_R$ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซรามิกมีโครงสร้างเป็นแบบรอมบ์ศิริลามากยิ่งขึ้น เมื่อบริมาณ x เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นที่ปริมาณ $x > 0.06$ พีคกราฟมีการเลื่อนไปทางมุมที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพีคกราฟที่ $x=0$



รูปที่ 23 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีของเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-x\text{BCTZ}$ ที่อุณหภูมิซินเตอร์ 1125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

4.6 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-x\text{BCTZ}$ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope)



รูปที่ 24 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-x\text{BCTZ}$ ที่ (a) $x=0$ (b) $x=0.02$ (c) $x=0.04$ (d) $x=0.06$ (e) $x=0.08$ (f) $x=0.1$ ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

จากการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ที่ $0 \leq x \leq 0.1$ โดยที่ x เพิ่มขึ้นทีละ 0.02 ดังแสดงในรูปที่ 24 พบร้าเกรนเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ที่ $x=0$ มีลักษณะแบบคิวบิกและมีรูพรุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยที่ปริมาณ x เพิ่มขึ้นพบว่าเกรนเซรามิกมีความคงทนมากขึ้น ที่ $x=0.02$ และ 0.04 รูพรุนเริ่มลดน้อยลงและขอบเกรนเริ่มเห็นชัดขึ้น (รูปที่ 24 (b), (c)) เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นถึง 0.06 พบร้ารูพรุนของเซรามิกลดลงอย่างเห็นได้ชัด (รูปที่ 24 (d)) และที่ปริมาณ x มากราว 0.06 รูพรุนเพิ่มขึ้น (รูปที่ 24 (e), (f)) ขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิกมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ x เพิ่มขึ้น เนื่องจาก BCTZ ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเกรนเซรามิก

ตารางที่ 4 ขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ที่ $0 \leq x \leq 0.1$ โดยที่ x เพิ่มขึ้น ทีละ 0.02 ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

x	ร้อยละความบริสุทธิ์	ขนาดเกรนเฉลี่ย (μm)
0	100	1.158
0.02	100	0.977
0.04	100	0.936
0.06	100	0.914
0.08	100	0.875
0.1	100	0.838

4.7 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$

นำเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ที่ผ่านกระบวนการซินเตอร์ มาทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความหนาแน่น และร้อยละการหดตัวเชิงเส้น พบร้าค่าความหนาแน่นของเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ มีค่าลดลงเมื่อ x เพิ่มขึ้นที่ $x=0.02$ หลังจากนั้นค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ x เพิ่มขึ้นจนถึง 0.06 และค่าความหนาแน่นมีค่าลดลงเมื่อ $x > 0.06$ ที่ปริมาณ $x=0.06$ เซรามิกมีความหนาแน่นเท่ากับ 5.42 g/cm^3 ในขณะที่ร้อยละการหดตัวเชิงเส้นลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ x เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 5 ค่าความหนาแน่นและร้อยละการหดตัวของเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ที่ $0 \leq x \leq 0.1$ โดยที่ x เพิ่มขึ้นทีละ 0.02 ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

Composition (g)	ค่าความหนาแน่น (g/cm^3)	ร้อยละการหดตัว (%)
0	5.64	19
0.02	5.38	18.2
0.04	5.39	18.06
0.06	5.42	17.73
0.08	5.23	17.13
0.1	5.12	16.46

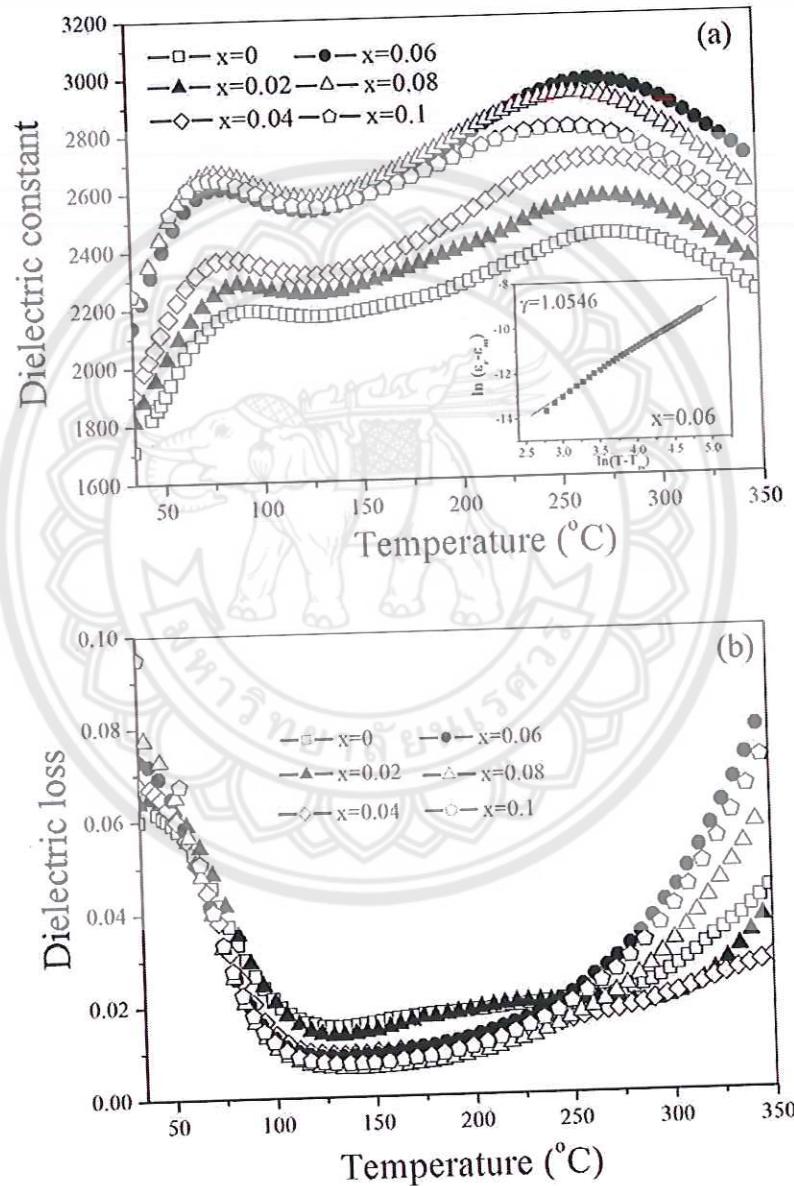
4.8 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$

สมบัติได้อิเล็กทริกของเซรามิก $(1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ$ ที่ปริมาณ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1$ วัดที่ความถี่ 1 kHz แสดงในรูปที่ 25 พบว่าเส้นกราฟได้อิเล็กทริกแสดงการเปลี่ยนแปลงความโค้งเป็น 2 ช่วงในทุกอัตราส่วน โดยการเปลี่ยนแปลงความโค้งช่วงแรกแสดงถึงการเปลี่ยนเฟสจากเฟสเฟรโรอิเล็กทริกไปเป็นแอนติเฟรโรอิเล็กทริก ที่อุณหภูมิประมาณ $\sim 80^\circ\text{C}$ เรียกอุณหภูมิตั้งกล่าวว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส (Transition temperature; T_p) และการเปลี่ยนแปลงความโค้งช่วงที่สองเกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 260°C ซึ่งแสดงการเปลี่ยนเฟสจากแอนติเฟรโรอิเล็กทริกไปเป็นพาราอิเล็กทริก โดยเรียกอุณหภูมิตั้งกล่าวว่าอุณหภูมิคิรี (Curie temperature; T_c) เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นพบว่าค่าของ T_p และ T_c มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก $BCTZ$ ที่เติมเข้าไปนั้นมีอุณหภูมิ T_c ที่ต่ำ [4-7] ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ϵ_r) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ($\tan \delta$) ที่อุณหภูมิห้องของเซรามิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 6 สำหรับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคิรี (ϵ_{r0}) มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นจนถึงที่ $x=0.06$ และเมื่อปริมาณ x มากกว่า 0.06 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีแนวโน้มลดลงโดยค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ($\tan \delta$) มีค่าอยู่ในช่วง 0.01-0.02 ซึ่งแสดงว่าปริมาณ x ไม่มีผลต่อค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก

ค่าคงที่การแพร่ (diffuse phase ; γ) ของเซรามิกซึ่งอธิบายการแพร่ของการเปลี่ยนแปลงเฟสตามกฎคิรี-ไวส์ (Curie-Weiss law)

$$\frac{1}{\epsilon_r} - \frac{1}{\epsilon_m} = C^{-1}(T - T_m)^\gamma, \quad (T > T_m)$$

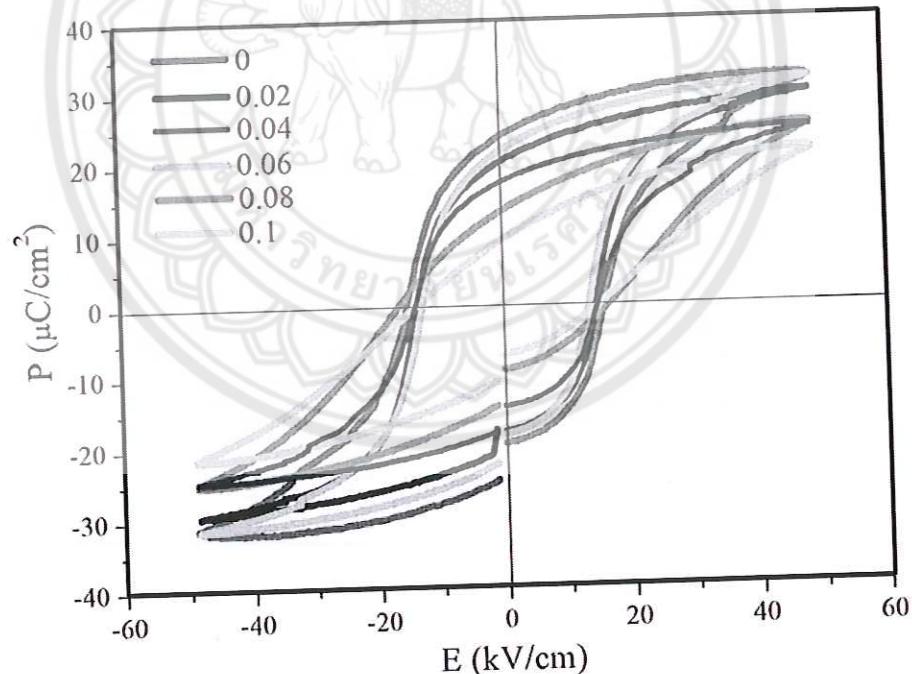
ค่า γ มีค่าระหว่าง 1-2 เมื่อ $\gamma=1$ เรียกว่าเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบปกติ (normal ferroelectrics) และเมื่อ $1<\gamma<2$ เรียกว่ารีแล็กเซอร์เฟอร์โรอิเล็กทริก (relaxer ferroelectrics) และที่ $\gamma=2$ เกิดการแพร่oyer อย่างสมบูรณ์ (complete diffuse phase) [10] ค่า γ ของเซรามิกมีค่าอยู่ในช่วง 1.03-1.06 ดังแสดงในตารางที่ 6 ซึ่งพบว่าเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-x\text{BCTZ}$ ที่ปริมาณ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1$ แสดงสมบัติเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบปกติในทุกตัวอย่าง



รูปที่ 25 สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-x\text{BCTZ}$ ที่ $0 \leq x \leq 0.1$ โดยที่ปริมาณ x เพิ่มขึ้นทีละ 0.02 (a) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและ (b) ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก

วงวนฮีสเทอเรชิส (P-E loops) ที่อุณหภูมิห้องของเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-xBCTZ$ ที่ปริมาณ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08$ และ 0.1 ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1125°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้สนามไฟฟ้าในการตรวจวัดที่ 50 kV/cm แสดงในรูปที่ 26 จากการวิเคราะห์ค่าสภาพขั้วคงค้างที่ของโพลาไรเซชัน (remnant polarization; P_r) พบว่าค่า P_r ลดลงเมื่อปริมาณ $0 \leq x \leq 0.04$ และที่ของโพลาไรเซชัน (remnant polarization; P_r) พบว่าค่า P_r ลดลงเมื่อปริมาณ $0 \leq x \leq 0.04$ และที่ปริมาณ $x=0.06$ ค่า P_r มีค่าเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นลดลงอีกครั้งดังแสดงในตารางที่ 6 ค่าสนามไฟฟ้าลบตัวอย่างปริมาณ $x=0.06$ ค่า P_r มีค่าเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นลดลงเมื่อ $x > 0.06$ โดยค่า E_c ที่มีค่าต่ำที่สุดพบที่ 0.06 จากนั้นเมื่อ $x=0.08$ ค่า E_c เพิ่มขึ้น และลดลงเมื่อ $x > 0.08$ โดยค่า E_c ที่มีค่าต่ำที่สุดพบที่ 0.06 จากนั้นเมื่อ $x=0.08$ ค่า E_c เพิ่มขึ้น และลดลงเมื่อ $x > 0.08$ โดยค่า E_c ที่มีค่าต่ำที่สุดพบที่ 0.06 ตัวอย่างปริมาณ $x=0.06$ ดังแสดงในตารางที่ 6

ค่าคงที่โพลิโซอิเล็กทริก (d_{33}) ของเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-xBCTZ$ ที่ปริมาณ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08$ และ 0.1 ตามลำดับ ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1125°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก 160 ถึง 237 pC/N เมื่อปริมาณ x เพิ่มจาก 0 เป็น 0.06 และเมื่อปริมาณ $x > 0.06$ ค่าคงที่โพลิโซอิเล็กทริกมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะเห็นว่าที่ $x=0.06$ ค่าโพลิโซอิเล็กทริกมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 237 pC/N ดังแสดงในตารางที่ 6



รูปที่ 26 วงวนฮีสเทอเรชิสของเซรามิก $(1-x)[\text{BNT-BKT-KNN}]-xBCTZ$ ที่ $x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08$ และ 0.1

ตารางที่ 6 ผลของการเปลี่ยนแปลงและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ

x	อุณหภูมิการเปลี่ยน แปลง ($^{\circ}\text{C}$)	ε_r	$\tan \delta$ at T_r	ε_{max} at T_c	$\tan \delta$ at T_c	γ	P_r ($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)	E_c (kV/cm)	d_{33} (pC/N)
	T_p	T_c							
0	94	274	1750	0.0607	2435	0.0214	1.05194	22.92	19.86
0.02	88	273	1851	0.0643	2558	0.0192	1.06836	19.48	17.45
0.04	84	272	1954	0.0673	2700	0.0178	1.03425	16.98	15.24
0.06	80	267	2187	0.0724	2971	0.0272	1.05465	20.83	13.74
0.08	78.9	259	2230	0.0773	2924	0.0182	1.03042	13.14	15.68
0.1	78.78	254	2293	0.0911	2807	0.0211	1.04885	9.44	14.66
									162

บทที่ 5

บทสรุป

สรุปผลการทดลองการเตรียมเซรามิก (1-x)[BNT-BKT-KNN]-xBCTZ

การเตรียมเซรามิก $(1-x)[\text{BNT}-\text{BKT}-\text{KNN}]-x\text{BCTZ}$ ที่ปริมาณ $0 \leq x \leq 0.1$ ด้วยวิธีการเผาใหม่โดยใช้ไกลซีนเป็นเชื้อเพลิง พบร่วมกับเซรามิก $(1-x)[\text{BNT}-\text{BKT}-\text{KNN}]-x\text{BCTZ}$ แสดงโครงสร้างเฟสเพอร์ฟลักติกที่ปริสุทธิ์ในทุกอัตราส่วน โดยที่ปริมาณ x อยู่ระหว่าง $0-0.04$ เซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสแบบเทหะร์โนนัล และที่ปริมาณ $x \geq 0.06$ เซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสแบบผสมระหว่างเทหะร์โนนัลและรวมไปยังรัล เมื่อปริมาณ $x > 0.06$ เซรามิกมีโครงสร้างเฟสเข้าสู่รอมไปยังรัลมากขึ้น ขนาดเกรนเฉลี่ย อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส (T_d) และอุณหภูมิครุภัย (T_c) ของเซรามิกลดลงเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น สมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและบริเวณรอยต่อเฟส (MPB) พบร่วมกับปริมาณ $x=0.06$ ซึ่งแสดงค่า $\varepsilon_m=2971$, $d_{33}=237$ pC/N และแสดงสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกที่แข็งแรง ($P_r=20.83$ $\mu\text{C}/\text{cm}^2$, $E_c=13.74$ kV/cm) โดยงานวิจัยนี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไฟฟ้าอิเล็กทริกที่ปราศจากตะกั่ว เนื่องจากเซรามิกนี้แสดงสมบัติไฟฟ้าอิเล็กทริกสูงและสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกที่ดี

បររណាអុក្រម

1. G.A. Smolenskii, V.A. Isupov, A.I. Agranovskaya, N.N. Krainik, New ferroelectrics of complex composition. Phys. Solid State **2(11)**, 2651-2654 (1961)
2. J.V. Zvirgzds, P.P. Kapostis, T.V. Kruzina, X-ray study of phase transitions in ferroelectric $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{TiO}_3$. Ferroelectrics **40**, 75-77 (1982)
3. H. Nagata, T.Takenaka, Additive effects on electrical properties of $(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3$ ferroelectric ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. **21**, 1299–1302 (2001)
4. W.J. Ji, Y.B. Chen, S.T. Zhang, B. Yang, X.N. Zhao, Q.J. Wang, Microstructure and electric properties of lead-free $0.8\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3-0.2\text{Bi}_{1/2}\text{K}_{1/2}\text{TiO}_3$ ceramics. Ceram. Int. **38**, 1683–1686 (2012)
5. T. Takenaka, K. Maruyama, K. Sakata, $\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3-\text{BaTiO}_3$ system for lead-free piezoelectric ceramics. Jpn. J. Appl. Phys. **30**, 2236–2239 (1991)
6. Q. Gou, J. Wu, A. Li, B. W, D. Xiao, J. Zhu, Enhanced d_{33} value of $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3-(\text{Ba}_{0.85}\text{Ca}_{0.15})(\text{Ti}_{0.90}\text{Zr}_{0.10})\text{O}_3$ lead-free ceramics. J. Alloy. Comp. **521**, 4– 7 (2012)
7. A.B. Kounga, S.T. Zhang, W. Jo, T. Granzow, J. Rodel, Morphotropic phase boundary in $(1-x)\text{Ba}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3-x\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{NbO}_3$ lead-free piezoceramics. Appl. Phys. Lett. **92**, 222902 (2008)
8. X.X. Wang, X.G. Tang, H.L.W. Chan, Electromechanical and ferroelectric properties of $(\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5})\text{TiO}_3-(\text{Bi}_{0.5}\text{K}_{0.5})\text{TiO}_3-\text{BaTiO}_3$ lead-free piezo-electric ceramics. Appl. Phys. Lett. **85**, 91 (2004)
9. A. Singh, R. Chatterjee, Structural, electrical and strain properties of stoichiometric $1-x-y\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3-x\text{Bi}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{TiO}_3-y\text{Na}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{NbO}_3$ solid solutions. J. Appl. Phys. **109**, 024105 (2011)
10. R. Sumang, Fabrication of lead-free piezoelectric ternary ceramics systems based on bismuth sodium titanate-bismuth potassium titanate prepared using the combustion technique: Thesis Ph.D. in Applied Physics, Naresuan University, 95-117 (2014)
11. Z. Yang, B. Liu, L. Wei, Y. Hou, Structure and electrical properties of $(1-x)\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3 -x\text{Bi}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{TiO}_3$ ceramics near morphotropic phase boundary. Mater. Res. Bull. **43**, 81-89 (2008)

12. W. Liu, X. Ren, Large piezoelectric effect in Pb-free ceramics. *Phys. Rev. Lett.* **103**, 257602 (2009)
13. D. Xue, Y. Zhou, H. Bao, C. Zhou, J. Gao, X. Ren, Elastic, piezoelectric, and dielectric properties of $\text{Ba}(\text{Zr}_{0.2}\text{Ti}_{0.8})\text{O}_3$ - $50(\text{Ba}_{0.7}\text{Ca}_{0.3})\text{TiO}_3$ Pb-free ceramic at the morphotropic phase boundary. *J. Appl. Phys.* **109**, 054110 (2011)
14. P. Julphunthong, T. Bongkarn, Phase formation, microstructure and dielectric properties of $\text{Ba}(\text{Zr}_{0.1}\text{Ti}_{0.9})\text{O}_3$ ceramics prepared via the combustion technique. *Curr. Appl. Phys.* **11**, 60-65 (2011)
15. C. Kornphom, A. Laowanidwatana, T. Bongkarn, The effects of sintering temperature and content of x on phase formation, microstructure and dielectric properties of $(1-x)(\text{Bi}_{0.4871}\text{Na}_{0.4871}\text{La}_{0.0172}\text{TiO}_3)\text{-}x(\text{BaZr}_{0.05}\text{Ti}_{0.95}\text{O}_3)$ ceramics prepared via the combustion technique. *Ceram. Int.* **39**, 421-426 (2013)
16. R. Sumang, N. Vittayakorn, T. Bongkarn, Crystal structure, microstructure and electrical properties of $(1-x-y)\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3\text{-}x\text{Bi}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{TiO}_3\text{-}y\text{BiFeO}_3$ ceramics near MPB prepared via the combustion technique. *Ceram. Int.* **39**, 409-413 (2013)
17. P. Julphunthong, S. Chootin, T. Bongkarn, Phase formation and electrical properties of $\text{Ba}(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$ ceramics synthesized through a novel combustion technique. *Ceram. Int.* **39**, 415-419 (2013)
18. C. Wattanawikkam, N. Vittayakorn, T. Bongkarn, Low temperature fabrication of lead-free KNN-LS-BS ceramics via the combustion method. *Ceram. Int.* **39**, 399-403 (2013)
19. P. Julphunthong, T. Bongkarn, Phase formation, microstructure and dielectric properties of $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.74}\text{K}_{0.16}\text{Li}_{0.10})_{0.5}\text{TiO}_3\text{-Ba}(\text{Zr}_{0.5}\text{Ti}_{0.95})\text{O}_3$ ceramics prepared via combustion technique. *Mater. Res. Innov.* **18(S2)**, 151-156 (2014)
20. C. Wattanawikkam, S. Chootin, T. Bongkarn, Crystal Structure, microstructure, dielectric and piezoelectric properties of lead-free KNN ceramics fabricated via the combustion method. *Ferroelectrics* **473**, 24-33 (2014)

21. K.A. Razak, C.J. Yip, S. Sreekanth, Synthesis of $(\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5})\text{TiO}_3$ (BNT) and Pr doped BNT using the soft combustion technique and its properties, *J. Alloy. Compd.* **509**, 2936-2941 (2011)
22. S.S. Manoharan, J. K.C. Patil, Combustion synthesis of metal chromite powders. *J. Am. Ceram. Soc.* **75**, 1012-1015 (1992)
23. B. Jaffe, W.R. Cook, H. Jaffe, *Piezoelectric ceramics*. London: Academic Press. (1971)
24. G.H. Haertling, Ferroelectric ceramics: History and technology. *Journal of the American Ceramic Society*, **82**, 797-818 (1999)
25. T. Comyn, The role of employers in the development of employability skills in novice workers. Doctoral dissertation, Ph.D., University of Leeds, U. K. (1998)
26. J.M. Herbert, *Ceramics dielectric and capacitors*. London: Gordon and Breach Scienec publishers. (1985)
27. S. Ananta, N.W. Thomas, Relationships between sintering conditions microstructure and dielectric properties of lead magnesium niobate, *J. Eur. Ceram. Soc.*, **19**, 629-635 (1999)
28. S. L. Swartz, T. R. Shrout, W. A. Schulze, L. E. Cross, Dielectric properties of lead-magnesium niobate ceramics, *J. Am. Ceram. Soc.*, **67**, 311-315 (1984)
29. P. Papet, J. P. Dougherty, T. R. Shrout, Particle and grain size effects on the dielectric behavior of the relaxor ferroelectric $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$, *J. Mater. Res.*, **5(12)**, 2902-2909 (1990)
30. T. Bongkarn, W. Tangkawsakul, Low temperature preparation of antiferroelectric PZ and PBZ powder Using the Combustion technique. *Ferroelectrics*, **383**, 50-56 (2009)
31. K.C. Patil, S.T. Aruna, T. Mirmani, Combustion synthesis: an update. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, **6**, 507-512 (2002)
32. A.G. Merzhanov, I.P. Borovinskaya, Combustion science and technology, **43**, 127,165 (1985)
33. A.G. Merzhanov, *Combustion and plasma synthesis of high temperature materials*, New York: VCH Publication. (1990)

34. สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์. (1992). กระบวนการประดิษฐ์สำหรับเซรามิกขั้นสูง. ใน เอกสารการประกอบการสอนรายวิชา ว. วศ. 210443. เชียงใหม่: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
35. กฤษณ ศิวເລີສກມລ (2545). ກລ້ອງຈຸດທຽບສິນເລື່ອຕຽບແບບສ່ວນກາດແລະອຸປະກອນວິເຄາະທີ່ ຈາກຮັງສືເອກົ່າ, ໃນເຄື່ອງມືອົງວິຈັຍທາງວັສດຸ: ທຸກໆກົງແລະການທຳງານເບື້ອງຕົ້ນ. (ຫນ້າ 289-305). ກຽມເທິງ: ສຳນັກພິມພົ່ງຈຸພາລັງກຣນົມໝາວິທຍາລັບ.
36. ສຸਰິນທຣ ລຶ່ມປະາທ ແລະ ຄຣີໄລນ ບູນທນ. (2543). ເຄື່ອງເອກົ່າເຮົດໃຫຼືພແກຣກຂັ້ນ. ໃນເຄື່ອງມືອົງວິຈັຍທາງວັສດຸ: ທຸກໆກົງແລະການທຳງານເບື້ອງຕົ້ນ. (ຫນ້າ 309-322). ກຽມເທິງ: ສຳນັກພິມພົ່ງຈຸພາລັງກຣນົມໝາວິທຍາລັບ.
37. ປະລັດ ວິໄຕໂຈນ. (2543). ການທາຄວາມໜາແນ່ນດ້ວຍເຄື່ອງໜ້າໄຟຟ້າ, ໃນເຄື່ອງມືອົງວິຈັຍທາງວັສດຸ: ທຸກໆກົງແລະການທຳງານເບື້ອງຕົ້ນ. (ຫນ້າ 158-166) ກຽມເທິງ: ສຳນັກພິມພົ່ງຈຸພາລັງກຣນົມໝາວິທຍາລັບ.
- 38 C. Kornphom, T. Bongkarn, The Effect of firing temperatures on phase evolution, microstructure, and electrical Properties of $\text{Ba}(\text{Zr}_{0.05}\text{Ti}_{0.95})\text{O}_3$ ceramics prepared via combustion technique, Mater. Sci. 20, 4 (2014)